# TripleQuad<sup>™</sup> / QTRAP®

LC-MS/MS System

シリーズ

初級定量トレーニングテキスト

- SCIEX OS ソフトウェア説明用資料 -

(測定: SCIEX OS, 定量: SCIEX OS)

# メソッド開発

ソフトウェアのバージョンにより、画面や操作方法が若干異なる場合があります。 予めご了承ください。

株式会社 エービー・サイエックス アプリケーションサポート *2025 年 5 月* 



# 目次

1	講義	資料1-1			
<b>2</b>	ソフ	・トウェアの概要			
3	SCIEX OS ソフトウェアの起動と各モードについて				
4	測定4				
	4.1	測定の流れ			
	4.2	ソフトウェアの起動			
	4.3	プロジェクトの作成			
	4.4	装置の Configuration			
	4.5	機器の平衡化			
	4.6	最適化			
	A) M	S 内部のパラメータの最適化(Infusion による自動最適化)			
	B)√	オンソースの最適化(FIA による自動最適化)4-19			
	4.7	測定メソッド(Acquisition Method)の完成(MS Method) 4-31			
	4.8	測定メソッド(Acquisition Method)の完成(LC Method)			
	4.9	測定			
<b>5</b>	停止	操作			
6	デー	·タの確認			
7	SCI	EX OS Software を用いた定量解析			
	7.1	SCIEX OS Software の Analytics の起動			
	7.2	Project の選択			
	7.3	初期設定の変更			
	7.4	Result Table の作成			
	7.5	Results Table の確認、編集			
	7.6	クロマトグラムの表示			
	7.7	パラメータの変更			
	7.8	手動積分			
	7.9	検量線の表示、重みづけ、検量線の種類を変更			
	7.10	データの追加と削除			
	7.11	Report の作成			

本マニュアル中での装置の表示について、一部下記のように表示しております。

人	略称	
SCIEX Triple Quad™	SCIEX QTRAP®	
4500 LC/MS/MS	4500 LC/MS/MS	4500シリーズ
System	System	
SCIEX Triple Quad™	SCIEX QTRAP®	
5500 LC/MS/MS	5500 LC/MS/MS	5500シリーズ
System	System	
SCIEX Triple Quad	SCIEX QTRAP®	
5500+ LC·MS/MS	5500+ LC·MS/MS	5500+3/117
System - QTRAP	System - QTRAP	5500+2-7 - X
Ready	Activated	
SCIEX Triple Quad™	SCIEX QTRAP®	
6500 LC/MS/MS	6500 LC/MS/MS	6500シリーズ
System	System	
SCIEX Triple Quad <sup>™</sup>	SCIEX QTRAP®	
6500+ LC/MS/MS	6500+ LC/MS/MS	6500+シリーズ
System	System	
SCIEX Triple Quad™	SCIEX Triple Quad™	
7500 LC-MS/MS	7500 LC·MS/MS	75003711-57
System – QTRAP®	System $\neg$ QTRAP®	1500 2 9 - 7
Ready	Activated	
SCIEX Triple Quad™	SCIEX Triple Quad™	
7500+ LC·MS/MS	7500+ LC·MS/MS	
System – QTRAP®	System – QTRAP®	7500+シリーズ
Ready	Activated	

# 1 講義資料

初級定量トレーニングコース – 講義資料 –
サイエックス アプリケーションサポート
2025/04
© 2023 DH Tech. Dev. Pie. Ltd. The Power of Precision
1
目次 The New of Prediction
• LC-MSの概要
・ LC-MSの概要 <ul> <li>・ 測定メソッドと自動最適化 (メソッド作成)</li> <li>- ルーチン分析の方は参考資料になります。</li> </ul>
<ul> <li>LC-MSの概要</li> <li>測定メソッドと自動最適化 (メソッド作成)         <ul> <li>ルーチン分析の方は参考資料になります。</li> </ul> </li> <li>その他のTips</li> <li></li></ul>
<ul> <li>・ LC-MSの概要</li> <li>・ 測定メソッドと自動最適化 (メソッド作成)         <ul> <li>・ ルーチン分析の方は参考資料になります。</li> </ul> </li> <li>・ その他のTips         <ul> <li>・ その他のTips</li> <li>・ パーチン分析コースの方は このマークのあるページ以外は参考資料になります。</li> </ul> </li> <li>MS用語について:         <ul> <li>Updateされることがありますので、正式な定義などにつきましては以下を参照ください。</li></ul></li></ul>



















イオン化

蒸発

(表面張力<クーロン力)

3.

Orifice (DP)

Curtain Gas (CUR)



イオン	イオン化法とイオン化されやすい部分構造 SCIEX							
	最大 質量	Positive Mode	Negative Mode					
ESI	10000 以上	R—NH <sub>z</sub>	R—S0,,H R—S0,,X R—0—S0,,H R—0—S0,,X R—C00H R—C00X	CH				
APCI	1000 程度	$\begin{array}{ccc} R - NH_{z} & R - COOR' & R - CONH_{z} \\ 0 \\ R - R' & R - CHO \\ \end{array}$	R—S0 <sub>9</sub> H R—S0 <sub>9</sub> X R—0—S0 <sub>9</sub> H R—0—S0 <sub>9</sub> X R—C00H R—CD0X	CH				
18		0 H 0 R1-11-R3 R1-11-( R2 f	$C = C \xrightarrow{H} R3 \qquad CH \\ H \xrightarrow{R2} N$	© 2023 DH Tech. Dev. Pie. Ltd.				





























#### 略語一覧

ESI: Electrospray Ionization

(大気圧下で行われるイオン化の一つで、エレクトロスプレー技術を使ったイオン 化法)

APCI: Atmospheric Pressure Chemical Ionization

(大気圧下で行われるイオン化の一つで、通常は大気圧スプレーによって生成した 気体試料を、コロナ放電で生成させたイオン種(反応イオン)と反応させてイオン化 すること)

- LC: Liquid Chromatography(液体クロマトグラフィ)
- IC: Ion Chromatography(イオンクロマトグラフィ)
- FIA: Flow Injection Analysis

(注入したサンプルをLCカラムを使わずに分析する方法)

m/z: Mass-to-charge ratio

(質量電荷比。 イオンの質量(m)を電荷数(z)で割った値)

MRM: Multiple Reaction Monitoring

(Q1 で選択された特定の前駆イオン (Precursor ion) から生じる特定のイオン の 質量を連続的に検出する方法)

Q1MS : Q1 MS Scan

(マススペクトルを測定するために、Q1 で走査したイオンを検出する方法)

Q3MS: Q3 MS Scan

(マススペクトルを測定するために、Q3 で走査したイオンを検出する方法)

EMS: Enhanced MS Scan

(Liner Ion Trap を利用して、走査したイオンを検出する方法)

 $MS2: \quad \text{Product Ion Scan}$ 

(特定の前駆イオン (Precursor ion) から生じるイオン (Product ion) を検出する 方法)

EPI: Enhanced Product Ion Scan

(Liner Ion Trap を利用して Product Ion を検出する方法)

- Prec: Precursor Ion Scan (特定のプロダクトイオンを生じる総ての前駆イオンを検出する方法)
- NL: Neutral Loss Scan

(特定の中性化学種を脱離する総ての前駆イオンを検出する方法)

IDA: Information Dependent Acquisition

(サーベイスキャンで取得した MS スペクトルから強度の強いイオンを選択し、リアルタイムで MS2 あるいは EPI のデータを取得する方法)

DP: Declustering Potential

(イオンを MS 内部へ引き込むための電圧であり、オリフィスプレートに電圧がかかる)

CE: Collision Energy

(MS/MS などの CAD 実験において、Q2 でイオンを加速させるための電圧であり、 Q0 と Q2 の電位差で表示される)

- LLOQ: Low Limited of Quantification(定量下限值)
- LOD: Low Limited of Detection(検出下限值)
- %CV: Coefficient of Variance (in percent)
- RT: Retention Time(保持時間)
- S/N: Signal to Noise
- IS: Internal Standard(内部標準物質)

# 2 ソフトウェアの概要

# SCIEX OS<sup>®</sup>ソフトウェアのファイル構造

- ワークステーションの C:ドライブに OS、x:ドライブ(x:納入先仕様により D、E、F 等 異なります)に SCIEX OS<sup>®</sup>ソフトウェアにて取得したデータ等が保存されています。
   This PC > DATA (D:) > SCIEX OS Data
- 全てのデータ、分析メソッド等は項目(日付、分析者、成分名等)ごとに分類することが でき、これを Project と呼びます。

各 Project にはそれぞれの【Project 名】をつけることができます。

• データ等は該当【Project 名】フォルダ内の Data フォルダ内に保存されます。

(x:// SCIEX OS Data/【Project 名】/Data)

 SCIEX OS <sup>®</sup>ソフトウェアによって作成されるファイルの種類は様々ありますが、ファ イルの種類により特定の拡張子が自動的に付けられます。高い頻度で用いられるの は、.msm(MS メソッド)、.lcm(LC メソッド)、.bch(バッチ)、.wiff(データ)、.qmethod(解 析メソッド)及び.qsession(定量結果)です。

### **Project**

 SCIEX OS<sup>®</sup>ソフトウェアでは、データや測定法、定量結果などを、Project ごとに管理 しています。Project は、SCIEX OS<sup>®</sup>ソフトウェア上部の Status Panel(例: ❷<sup>Ready</sup>)を クリックあるいはホーム画面の Configuration から Project を選択することで表示され、 プルダウンメニューにより選択できます。



- データや測定法、定量結果などは、そのファイルが保存されている Project を選択している時のみ開くことができます。ただし、すでに開いているメソッドやデータなどは、 Project を変更しても表示されたままです。
- 新たに測定を開始する時や、測定者が変わる時などは違う Project を作成し、使用する ことが可能です。
- 例えば、ある測定者が Project を作成し、Project 内でメソッドやデータを保存した場合、該当する Project を選択するだけで自分のファイルだけを見ることができるようになります。(x:// SCIEX OS Data/【Project 名】)

# <u> バックアップについて</u>

 バックアップを取る際は、SCIEX OS<sup>®</sup>ソフトウェアがインストールされているドライ ブ x:// SCIEX OS Data のフォルダごとバックアップすることをお勧め致します。

# 3 SCIEX OS ソフトウェアの起動と各モードについて

#### <u>SCIEX OS Software ホーム画面</u>

Desktop のアイコン **うう**をダブルクリックし、software を起動します。

- Acquisition:装置のチューニングおよび測定用のメソッド、バッチを作成し、データを 取り込みます。
- Processing: データの閲覧および組成解析等の定性解析、定量解析、ライブラリー検索 等を行います。
- Management:機器の認識およびライブラリーのインポート、ユーザー登録等を行います。
- 複数のWindowを表示した際、最初の画面に戻る際はCアイコンをクリックするか、

別の設定に移る際はでアイコンをクリックします。						
0-		🐣 <mark>A</mark> 🧕	Ready ? - 🗆 ×			
C SCIEX 測 Acquisition	(OS <sub>定</sub>	解析 Processing	管理 Management			
Batch	Queue	Explorer	Configuration			
MS Method	LC Method	Analytics	Library			

画面は一例のため、お客様の画面と異なる場合がございます。

# 4 測定

4.1 測定の流れ



4.2 ソフトウェアの起動

<u>SCIEX OS ソフトウェアの起動</u>

Desktop のアイコン うをダブルクリックし、software を起動します。

または、Start メニュー> SCIEX OS>SCIEX OS から、SCIEX OS ソフトウェアを起動 します。

- 4.3 プロジェクトの作成
- ① 画面上部右上の Status Panel(例: O Stopped)をクリックします。

クリックを繰り返すことで表示/非表示になります。

② Projects の をクリックし、名称を入力して OK をクリックして新規プロジェクトを 作成します。

プロジェクトの保存先: D:¥SCIEX OS Data

既存のプロジェクトを選する場合はプルダウンから選択します。

Training では Project 名を Training とします。

K 🖉 Stopped	? – & ×
Projects	
Training	<b>⊻</b> ⊕
Acquisition samples waiting: Acquisition sample time remaining: Acquisition queue time remaining:	2 0d 0h 0m 0s 0d 0h 21m 12s
Devices	
<u>ExionLC</u>	Ħ 🕐
Binary Gradient - Pump B	
Autosampler	
Column Oven	
System Controller	
SCIEX Triple Quad™ 7500	<u>₩</u>
Syringe Pump Model	<u>+</u>

## 制御する機器を設定する

SCIEX OS ソフトウェアで制御する機器を設定します。

# 4.4 装置の Configuration

- ① Home 画面から Configuration をクリックし、画面を開きます。
- ② Devices をクリックし、MS と LC の Active にチェックが入っていることを確認して、 Active Devices をクリックします。

Deactivate する際はメソッドやバッチを閉じる必要があります。



- ③ アイコンの色で各装置の状態を確認します。
  - 青: Running → 平衡化中または測定中
  - 緑: Standby  $\rightarrow$  正常
  - 赤: Error → 接続状態やイベントログをご確認ください
  - ※ 接続されている全ての装置を Standby にするには、下部の Direct Control パネルの Standby アイコンをクリックします。
  - ※ Devices の装置名をクリックすることでその装置の詳細な状態(Device Details/Detailed Status)を表示することができます。
     (LC であれば流速や温度、MS であれば真空度やイオンソースの種類など)
  - ※ Шアイコン(点線)をクリックが可能な場合は、直接制御をすることができます。

R 🖉 Stopped	? - 8 ×	Device Details			X		
Projects		Device					
Projects		Device Name:	7500 HM SCIEX Triple Quad™ 7500				
Training	✓ (+)	Instrument Mode:	QTRAP ®				
In Root: D:\SCIEX OS Data		Manufacturer:	Sciex				
-		Firmware Version:	irmware Version: PIL2004 PIB1100 PIA1100 (210610 02 A2 D5152731G ) 210916 KOL0100 20200415				
Queue		Serial Number:	FA223172208				
Acquisition samples waiting: Acquisition sample time remaining: Acquisition queue time remaining:	2 0d 0h 0m 0s 0d 0h 21m 12s	Detailed Status					
			Mass Spec				
Devices							
<u>ExionLC</u>		Connection Status	<ul> <li>Device State</li> </ul>	Error			
		Connected	StandBy	N/A			
Binary Gradient - Pump B		イオンソ Sample Introd	'ースの種類 uction Status				
Autosampler		Source	Source Exhaust	Interface Heater			
		OptiFlow® Pro	On	Temp. OK			
Column Oven		Source Temperature	Ion Spray Voltage	Ion Path Electronics			
		35.0 C	34.2 C 0 V 2 V	V On			
System Controller		Accumulated Ions	Mass Mode				
SCIEX Triple Quad™ 7500		1.452E+011 counts	High				
Selex mple quid 7500			直空度				
Syringe Pump Model		Vacuum Syster	m Status				
		Vacuum Status	Vacuum Pressure	Backing Pump			
		OK	8.3 E-6 TOT	Enabled			
Direct Control		Turbo Pump					
		Yes					
(U)	$\bigcirc$						
Standby	Fouilibrate						
	Equilibrate						
					<u>O</u> K		

<機種やソフトのバージョンにより表示は異なります>

画面上部の × をクリックして画面を閉じます。

4.5 機器の平衡化

測定開始前や機器を初期条件に設定したい場合に、平衡化を行います。

- Status Panel をクリックし、下部の Direct Control の Equilibrate アイコンをクリック します。
   Direct Control
- 平衡化に使用する MS Method および LC Method を プルダウンより選択します。
- ③ 平衡化する時間を入力し、OKをクリックします。
   ※ 実際の測定では 15 分以上を推奨します。

quinorau	9/1	7.4	/
Direct Co	ntrol		
() Standby	y		) uilibrate
System Prepa	aration		X
Equilibrate			
MS Method MS N	/lethod		( <b>`</b>
LC Method LC N	lethod		<b>(</b>
Time (min.) 1	\$		
		ОК	Cancel

④ LC の溶媒が流れ、ガスやターボガスの加熱が始まります。入力した平衡化時間が経過 後に画面右上の Status Panel が<sup>◎ Equilibrating</sup>から<sup>② Ready</sup> に変わります。

#### 4.6 最適化

最適化を実施し、結果に基づいた MS メソッドを作成します。

測定用 MS メソッドを作成するには、A)MS 内部パラメータと B)イオンソースパラメー タの2種類の最適化を行います。MS 内部パラメータの最適化を行い、その後イオンソース パラメータの最適化を行います。

#### A) MS 内部のパラメータの最適化

- DP、EP、CE、CXP などの MS 内部パラメータを最適な値に設定します。
   (7500 および 7500+ シリーズは DP パラメータが削除されています)
- シリンジポンプを使って、一定の低流速で対象標準物質の溶液を持続注入しながら最 適化を行います。
  - ※ この操作を Infusion(IF)の最適化と呼びます。

【ヒント】

- ✔この最適化は成分ごとに行う必要があります。
- ✓可能な限り単成分の標準液を使用します。
- ✓イオン源の種類(ESI または APCI)が変わっても、最適化し直す必要はありません。 ※APCI での最適化は別冊の APCI 操作ガイドをご参照ください。

#### B) イオンソースのパラメータの最適化

- Curtain Gas、CAD Gas、Spray Voltage、Source temperature、Ion Source GS1、Ion Source GS2 などを最適な値に設定します。
- カラムを付けない状態でLC/MS/MSとして複数回注入動作を繰り返しながら最適化を 行います。

※ この操作を FIA(Flow Injection Analysis)の最適化と呼びます。

【ヒント】

✔10成分まで同時に測定できます。

✓イオン源の種類および LC 条件(流速や溶媒比率)が大きく変更された際には、再度最 適化を行います。

 Training では Reserpine 標準物質を用いて最適化から定量までを説明しますが、他の 成分でも同様の手順にて測定を行います。

#### <u>※参考</u>

#### Calculator を用いたモノアイソトピック質量(精密質量)と平均分子量の計算方法

- ※ 目的の化合物のモノアイソトピック質量を計算する方法です。
- ① Explorer から Show > Mass Calculators を選択します。
- Mass Property のタブをクリックし、Formula に計算する組成式(アダクトを加味したもの)を入力します。
- ③ Calculate をクリックすることで、Monoisotopic m/z にモノアイソトピック質量が表示されます(平均分子量は Charged average mass に表示されます)。

Mass Property AA Property	Positive Mod	e on Elemental Composition	Mass Property AA Prop N	legative Mode	pution Elemental Composition
• [			••••••		J
Formula:	C33H40N209	Calculate	Formula:	C33H40N2O9	Calculate
Charge state:	1	'H+' charge agent (else electron)	Charge state:	-1 🔽 'H-	+' charge agent (else electron)
Composition:	C33H41N2O9+		Composition:	C33H39N2O9-	
Charged monoisotopic mas	s: 609.28066		Charged monoisotopic ma	ass: 607.26610	
Monoisotopic m/z:	609.28066		Monoisotopic m/z:	607.26610	
Charged average mass:	609.696		Charged average mass:	607.673	
Nominal mass:	609		Nominal mass:	607	
RDB:	15.0		RDB:	15.0	

- ※ Formula には中性の組成式、'H+' charge agent (else electron)のチェックボック スにチェックを入れ、Charge State には1ないしは-1と入力すると、Positive Mode は+H、Negative Mode は-H として精密質量を自動計算できます。
- ※ Charge State 入力例: Positive Mode: 1, Negative Mode: -1

#### 同位体分布の計算と重ね書き

Isotopic Distribution タブをクリックし、組成を入力すると理論上の同位体ピークが 表示されます。

※ スペクトルに重ね書きする場合は、 <sup>山</sup> アイコンを目的のスペクトルにドラッグ してリンクした後、Overlay pattern on spectrum にチェックを入れてください。



A) MS 内部のパラメータの最適化(Infusion による自動最適化)

Infusion による最適化では MS を使用するため、Configuration は MS を含む状態で Activate のチェックを入れて Active の状態にします。

#### 【Infusion 最適化の準備 ーシリンジの接続ー】

- ①標準物質の溶液を調製します。
  - ※ Training では Reserpine を使用します。

※ Infusion の最適化時に使用する標準液の目安となる濃度

機種	濃度
4500 シリーズ	100 ng/mL
5500 および 5500+ シリーズ、6500 および 6500+ シリーズ、 7500 および 7500+シリーズ	10 ng/mL

- ② 標準溶液を1mLまたは5mLのガラスシリンジに詰めます。
- ③ シリンジポンプにセットします。
- ④ (ESIの) イオン源が装着されていることを確認します。
- ⑤ シリンジから繋がるピークチューブを 7500、7500+シリーズはバルブ、それ以外はス プリッターを経由しイオンソースへ接続します。


<u>スプレー位置の調整:</u> (7500、7500+シリーズは必要ありません) ・Infusion 測定時 (流速:5~20 µL/min 程度) 縦(Y)位置:5 横(X)位置:5 ※オリフィスに一番近い位置 になります。

・LCMS 測定時

(流速:200~500 μL/min 程度)
 縦(Y)位置:3 or 2
 横(X)位置:7

※オリフィスから少し離すことで感度が向上すると共に、汚れにくくなります。



【Infusion 最適化の準備 -ピークの確認-】		
① Home 画面の MS Method アイコンをクリックします。		
② 上部にある New の下矢印(右図参照)をクリックします。	New Open	•
③ Q1 を選択します。	Neutral Loss	
	(I Precursor Ion	
	Product Ion	
	Q1	
	Q1 MI	
	Q3	
	Q3 MI	
	IDA	
④ Method duration に測定時間を入力します。	Guided Optimization +	

- ※ 持続注入が安定しているかを確認するには、5~10分程度を入力します。
- ⑤ Scan rate を 1000 Da/s に設定します。
- ⑥ Start mass ならびに Stop mass にスキャンする範囲を入力します。
  - ※ Training で使用する Reserpine(分子量 608)の場合、Start mass に 590、Stop mass に 660 を入力します。

【ヒン】 ※ モノ	ト】 ハアイソ	トピック	ク質量の 10 I	Da 程度小	さい	直から、50 Da	a 程度大きい(
<ul><li>(ア)</li><li>※ 複数</li></ul>	ダクトイ 女化合物を	オンを を同時に	確認するため) ニ最適化する場	を入力し <sup>、</sup> 合、全てG	ます。 の化合	物が見られる	範囲とします。
Method duration	5	🗘 min	Total scan time:	0.075 s		Estimated cycles:	3995
	④測定問	<b>寺間</b>					
<ul> <li>Source and Gas Pa</li> </ul>	rameters -						
lon source gas 1	20	psi	Curtain gas	40	psi	Source temperature	0 🗘 °C
lon source gas 2	0	psi	CAD gas	0	•		
<ul> <li>Experiment Q1</li> </ul>	<b>~</b> -						⑤Scan rate
Polarity	Positive	~	Spray voltage	5500	<b>\$</b> V	Scan rate	1000 🔹 Da
Advanced Experiment	Settings						
Settling time	0	🗘 ms	Pause time	5	🗘 ms		
Q1 resolution	Unit	•	Step size	0.1	🤪 Da	_	
Mass Table Import from	m file					Q0 dissociation	Simple 💙
Start Si mass (Da) m	top Scan nass (Da) time (	EP s) (V)					
1 590.000 6 *	60.000 0.070	1 10.0	⑥スキャンする	質量範囲			
下部にある	Data Aco	quisitio	n バーの Star	tをクリッ	クしる	ます。	
Data Acquisitio	on	MS			(B)	Start 🔹 🖬 Stop	Save

8	以降を参考に流速け	5~10 uL/min	程度でシリンジポンプをスタートします。
U)	以阵での方に肌还は、	$0^{-10} \mu L/mm$	住反(インインハイノセハクードしょり。

# 【ヒント】

最初はチューブの中のエアーにより、スペクトルが不安定になることがありますが、 しばらく経つと安定します。急ぐ場合は、シリンジを少し手で押すか、流速を一時的 に 20 µL/min 程に上げることで、安定するまでの時間を短縮することが出来ます。

<u>シリンジポンプのスタート方法</u>
<ol> <li>Status Panelの Devicesの Syringe Pump Modelのアイコン 使 をクリックし、 Syringe Pump 情報を表示します。</li> <li>SCIEX 7500+ system</li> <li>Syringe Pump Model</li> <li>Yalve Model</li> <li>U</li> </ol>
② Syringe Diameter にシリンジの内径を選択ならびに Flow Rate を入力します。
<ul> <li>※ 納品時付属のガスタイトシリンジの内径が1 mL の場合は 4.61 mm、</li> <li>5 mL の場合は 10.3 mm にします。</li> </ul>
※ いずれも単位は「μL/min」を選択します。
Device Control     X       Syringe Diameter:     4.61mm(1mL) •       Flow Rate:     5       Flow Rate:     5       Flow Rate:     10.3mm(5mL) •       Flow Rate:     5       Start     Stop       Update     Unified was changed.       Start     Stop
③ Start ボタンをクリックします。
※ 測定途中で流速を変更したい場合は、Flow rate に流速を入力後 Update ボタンをクリックします。
※ シリンジポンプを止めたいときは、Stop ボタンをクリックします。

⑨ 以下の4項目を確認し、安定していれば Stop をクリックします。



a. 左下のクロマトグラム画面の TIC が安定していること

※ 画面下部の Data Acquisition をクリックすると TIC が表示できます。

- b. Positive、Negative Mode のどちらでイオン化するか確認すること
  - ※ Training で使用する Reserve の場合、Positive モードの方がよりイオン強度 が大きくなります(m/z 609)。
- c. 目的化合物由来のイオンが観測されていること
- d. 目的化合物由来のイオンのイオン強度が十分であること

機種	イオン強度
4500 シリーズ、5500 および 5500+ シリーズ、 6500 および 6500+ シリーズ、	10 <sup>5</sup> ~10 <sup>6</sup> cps 程度
7500 および 7500+ シリーズ	<u>106~108 cps 程度</u>

- ⑩ 必要に応じて Save ボタンから結果を保存します。
  - ※ Reserpine\_Q1\_posi と名前をつけて保存した場合、下記の場所に保存されます。

D:\SCIEX OS Data\ [Project 名] \Data \Reservine\_Q1\_posi.wiff

D:\SCIEX OS Data\ [Project 名] \Data \Reservine\_Q1\_posi.wiff2

D:\SCIEX OS Data\ [Project 名] \Data \Reservine\_Q1\_posi.wiff.scan



# 【Infusion 最適化の開始】

- ① Home 画面の MS Method アイコンをクリックします。
- ② 上部にある New の下矢印(右図参照)をクリックします。
- ③ Guided Optimization を選択し、MRM Infusion を選択します。

Neutral Loss Precursor Ion Product Ion Q1 Q1 MI Q3 Q3 MI

MRM FIA

- ④ メソッドの作成方法を選択します(Training では Automatic を選択)。
   ※ Guided にすると任意でパラメータ値の設定が可能になります。
- ⑤ 極性を選択します(Training では Positive を選択)。

Preparation			
Select the mode of optin	nization.		
Method Creation	Automatic	0	Polarity   Positive
$\bigcirc$	Guided		O Negative
メン	ノッドの作成:	方法を選択	極性を選択

- ⑥ Find transitions automatically を選択します(通常はこちらを使用します)。
- ⑦ 化合物名を入力します(Training では Reserpine を入力、SCIEX OS3.4 から最大 10 化 合物まで入力可)。
- ⑧ 価数を入力します(Training では1を入力)。
- ⑨ プリカーサーイオンの m/zを入力します(Training では Q1 Scan で確認した値を入力)。
- ⑩ 最適化するフラグメントイオンの数を入力します(Training では5を選択)。

## ※ 最大 10 まで選択可能です

Find transitions automatically

Intensity of ion exceed	f the precursor s	100	cps	Intensity of the p ion exceeds	product	100	cps
Exclude pro are within	oduct ions that +/-	5	Da of the	precursor ion			
▼ MRI Ma	M						
	Compo ID	und	Precursor ion mass (Da)		Charge	Num of fra	ber agments
1	Reserpi 化合物	ne 名を入力	<u>609.000</u> プリカーサー	イオンの m/z	1 価数をJ	5 (カ フラ	<u></u> グメントイオン数を
※ ソフ	フトのバーミ	ジョンによっ	て表示が異な	ります。		入力	
【ヒント】							
既知の MRM の剥	フラグメン 表に化合物:	トイオンで聶 名と Q1 およ	}適化する場合 び Q3 を入力	合は、Use kn します。	lown tran	nsitions を選	択し、
この表	は複数行入	力することか	<sup>ゞ</sup> でき、Excel	しにも対応して	ています。		
Use kr Enter th V	nown trans e transitions /IRM — Mass Tabl	itions ::					_
		Compound D	Q1 mass (Da)	Q3 mass (Da)			

	ID .	mass (Da)	mass (Da)
1	Reserpine 1	609.0000	195.0000
2	Reserpine 2	609.0000	174.0000
*			

⑪ 右上の Continue をクリックします。

### 12 MS パラメータは下記の初期パラメータを入力します。

※ 一度 Stop した後に再度 Start をクリックすることで設定値が反映されます。

Set Initial Conditions

2e5 -

0e0 1

1e5 606.1286 607.7667

607 608 Stop



### <Infusion 最適化のイオンソースのパラメータ初期値例>

610.2626

610 611

609

m/z, Da

611.2917

	設定範囲	4500 シリーズ、5500 および 5500+ シリーズ、 6500 および 6500+ シリーズ
Ion Source GS1	0~80	20
Ion Source GS2	0~80	0
Curtain Gas	$30 \sim 50$	35
CAD Gas	0 <b>~</b> 12	9
Source temperature	0 <b>~</b> 700	0
Spray Voltage	$0 \sim 5500$	5500 (4500)

	設定範囲	7500 および 7500+ シリーズ
Ion Source GS1	0~80	40
Ion Source GS2	0~80	0
Curtain Gas	$30 \sim 50$	40
CAD Gas	0 <b>~</b> 15	9
Source temperature	0 <b>~</b> 700	0
Spray Voltage	0 <b>~</b> 5500	5500 (4500)

※ カッコ()内は Negative モード時の設定値を表します。

- ③ Q1 測定の際と同様に以下の3項目を確認します。確認後、Next ボタンを押して自動最 適化を開始します。
  - a. 左下のクロマトグラム画面の TIC が安定していること
  - b. 目的化合物由来のイオンが観測されていること
  - c. <u>目的化合物由来のイオンのイオン強度が十分であ</u>ること

機種	イオン強度
4500 シリーズ、5500 および 5500+ シリーズ、	$10^{5} \sim 10^{6} \mathrm{cps}$ 程度
6500 および 6500+ シリーズ、	<u>(4.0e6以下)</u>
7500 および 7500+ シリーズ	<u>106~108 cps 程度</u>



- ※ プロダクトイオン、DP、CE、CXPの最適値が自動で選択されます。(DPは7500、 7500+シリーズ以外)
  - 右 :プロダクトイオンの選択画面
  - 左下: CE の最適化画面
  - 右下: CXP の最適画面



⑭ 自動で結果が表示され、必要に応じてデータを保存します。

<SCIEX OS3.4 未満>

※ 最適化したデータは、自動で下記フォルダ内に保存されます。

D:¥SCIEX OS Data¥TempData¥OPT-【測定日時】

- ※ 結果のレポートは、自動で保存されないため、ご注意ください。
- ※ 保存形式は XPS ファイルで保存されます。

Window10 は XPS Viewer が標準ではインストールされていないため、保存しても お客様のパソコンで開くことができない場合があります。必要に応じて PDF 形式 で印刷し、保存します。

※ 保存先はお使いのプロジェクト内あるいは Desktop など適宜保存します。

<SCIEX OS3.4 以上>

Report

※ 最適化したデータならびにレポートは、自動で下記フォルダ内に保存されます。

D:¥SCIEX OS Data¥【Project 名】¥Optimization¥GuidedMRM Optimization-【測定日時】

※ 保存形式は XPS ファイルで保存されます。

Window10 は XPS Viewer が標準ではインストールされていないため、保存しても お客様のパソコンで開くことができない場合があります。必要に応じて PDF 形式 で印刷し、保存します。

						Continue	Run Again Save report as
Report Generated 12	/22/2020 4:14:36 PM						レポートを保存
Include Optional	Steps						
				Pro	cessing Procedures	1 of 1 Pages:	4 of 4
🥪 🗋 🔍 🔍 🛯	* =						_
							A
	AB SCIEX MRM	I Generation Re	port		12/22/2020 4:14 PM		
	Instrument Name: SCIEX Triple	Quad™ 7500	Manufacturer:	AB Sciex			
	Instrument Model: TripleQuad	500	Target Instrument:	TripleQuad7500			
	Serial Number: FA2008200	IPL	Doc Num Revision:	MRMGeneratorOOO7500L	Eng		
	1. MRM Generator						
	Sten	Result	Defails				
	Preparation	Pass	Compound Name: Compound Mass: Number of Fragme Polarity: Positive	: Reserpine 609 ents to Find:5			
	Set Initial Conditions	Pass	Polarity: Positive Start mass: 560 Stop mass: 660 Scan rate: 200 Spray voltage: 550 Curtain gas: 40 Ion source gas 2: Temperature: 0	00 36 70			

- ① Continue ボタンをクリックすると最適化の結果が反映されたメソッドが新規保存また は既存メソッドに追加保存できます(Training では Reserpine\_MRM\_pos と名前をつけ て保存します)。
  - ※ このメソッドは下記の場所に保存されます。
  - ※ そのまま FIA を実施する際は、表示されたメソッドの MRM 条件を Excel にコピー することを推奨します。

D:\SCIEX OS Data\ [Project 名] \ Acquisition Methods \ Reservine\_MRM\_pos.msm

#### Select a Method

#### Select the mode of MRM method generation

Create a new method

Append MRM transitions to an existing method

The list of Existing Methods contains only those methods that are compatible with the options selected in previous steps.

Existing Method



⑥ Devices の Syringe Pump Model のアイコンをクリックし、Stop をクリックしシリンジを停止します。

- B)イオンソースの最適化(FIA による自動最適化)
  - ※ 必須ではありません。イオン源パラメータ初期値で測定し、期待の感度に達していない場合などに行います。
  - ※ FIA による最適化では LC および MS を使用するため、先述の機器の Configuration は LC および MS の両方の Activate にチェックを入れて Active にします。
  - ※ MS のみで Infusion を実施した場合は、LC を含む構成に接続し直す場合は、MS Method を保存し、MS Method を閉じます。

#### 【FIA 最適化の準備-LC の接続-】

- LC 移動相を準備します。
  - ※ 実際の測定時に使用する LC 溶媒を推奨します。
- ② 標準溶液を準備します。
  - ※ 標準溶液濃度の目安は下記をご参照ください。

機種	濃度
4500 シリーズ	10 ng/mL
5500 および 5500+ シリーズ、6500 および 6500+ シリーズ、 7500 および 7500+ シリーズ	1 ng/mL
【ヒント】	

| ※ Infusion 最適化時の 1/10~1/1 濃度の標準液を使用します。

- ③ LC と MS を接続します。
  - ※ カラムオーブンから出ているピークチューブを直接イオンソースに接続して下さい。
  - ※ 7500、7500+ シリーズは、カラムオーブンから出ているピークチューブをバルブに 接続して下さい。
- ④ 7500、7500+ シリーズ以外は、P.4-9の"スプレー位置の調整"のLC/MSの測定時の 項を参考にスプレー位置を調整します。



### 【FIA 用のメソッドの作成-MS メソッド-】

- Infusion で最適化した MS メソッドを上部の Open から選択して開きます(Training で は Reserpine\_MRM\_posi を選択)。
- ② Method duration に測定時間を入力します(Training では1分を入力)。

Method duration	1	\$ min	

③ Source and Gas Settings に下記のイオンソースの初期パラメータを入力します。

<FIA 最適化のイオンソースのパラメータ初期値>

4500 シリーズ、5500 および 5500+ シリーズ、6500 および 6500+ シリーズ

	設定範囲	TurboIonSpray (200 µL/min, FIA)	Heated Nebulizer (1000 µL/min,FIA)
Ion Source GS1	0 <b>~</b> 80	50	50
Ion Source GS2	0~80	60	N/A
Curtain Gas	$30 \sim 50$	40	40
CAD Gas	0 <b>~</b> 12	9	9
Source temperature	0 <b>~</b> 700	400	400
Spray Voltage	$0 \sim 5500$	5500 (4500)	-
Nebulizer current	$0\sim 5$	-	2 (2)

※ カッコ()内は Negative モード時の設定値を表します。

- ※ Negative の IS は最大 4500 です。
- ※ 設定温度(Temperature)は最大 700℃までにしてください。 750℃でも使用できますがヒーターの寿命が短くなるため、推奨しません。

	設定範囲	OptiFlow®Pro (E-ANALYT 200+ μL:ESI) (200 μL/min, FIA)	OptiFlow <sup>®</sup> Pro (APCI) (1000 µL/min,FIA)
Ion Source GS1	0 <b>~</b> 80	50	50
Ion Source GS2	0 <b>~</b> 80	60	N/A
Curtain Gas	$30 \sim 50$	40	40
CAD Gas	0 <b>~</b> 15	9	9
Source temperature	0 <b>~</b> 700	400	400
Spray Voltage	$0 \sim 5500$	5500(4500)	-
Nebulizer current	0~5	-	2 (2)

※ カッコ()内は Negative モード時の設定値を表します。

※ Negative の IS は最大 4500 です。

※ CUR の推奨値は 40 以上です。感度が十分な場合は 40 に設定して下さい。

※ TIS の設定温度(Temperature)は最大 700℃までにしてください。 750℃でも使用できますが、ヒーターの寿命が短くなりますので推奨しません。

④ 作成したメソッドを保存します(Training では Reserpine\_FIA\_pos として保存)。

# 【FIA 用のメソッドの作成-LC メソッド-】

FIA 最適化では、Infusion で最適化した MS メソッドの他に LC メソッドが必要です。 続いて LC メソッドを作成します。

- ① Home 画面の LC Method アイコンをクリックします。 🏠 IC Method
- ② 上部にある New をクリックします。
- ③ 以降の各 LC の入力方法を参考に以下の LC 条件を入力します。

カラム	なし			
移動相 :A :B	0.1%ギ酸を含む精製水、また アセトニトリル、またはメタノ	とは 0.1%酢酸を含む精製水 / −ル		
グラジエント				
Time [min.]	0	1.0		
A [%]	50 50			
B [%]	50 50			
流速(μl/min)	200			
カラム温度[℃]	40			
サンプルクーラー[°C]		5		
注入量 [µL]	1	0		

# 【ExionLC、島津社製 LC の場合】

- ① Binary Gradient タブをクリックします。
- Stop Time に 1.0min、Flow (流速)、B Conc. に適当な値を入力します。
- ※ 流速、移動相組成は、実際に使用する組成、 流速を入力してください。
- ※ 将来、グラジェントで分析される場合は、対 象成分が検出される時の溶媒組成を入力し て下さい。
- ※ A.Conc には入力できないため、B.Conc に 入力して下さい。
- ※ Training では 0.2 (mL/min) 、に 50 (%) を 入力してください。
- ③ Autosampler タブをクリックします。

Binary Gradier	t Autosampler	Column Oven	System Contr	oller
AD	Pump			
Stop time:	1.00 min			~
B.Conc A	.Conc			_
100				
80				
60 %				
40				
20				
0 0.00	0.20 0.40	) 0.60	0.80	1.00
Flow:	0.2000 mL/	min		
A.Conc	50.0 %			
B.Conc	50.0 %	B.Curve	0	
Pressure limi	ts:			
Minimum:	0.0 MPa	Maximum:	40 MPa	

④ Rinse Settings の Rinse Mode を Before and after aspiration に、Rinse Dip Time (オートサンプラーのニードル Wash 時間) に 0 sec を入力します。

Binary Gradient	Autosampler Column Oven System Controller
AD Au	tosampler Direct injection
<ul> <li>Autosample</li> </ul>	r – Sample rack settings – 👘 🕷
Sampling spee	gs     - Injection settings     8       d:     5.0     µL/s     - Acquisition cycle time optimization     8       operature:     15     °C     - Rinse settings     8
<sub>┌</sub> Rinse settings	-Purge settings
Rinse type:	External only  -Autopurge settings
	Refer flow channels
External Rinse mode:	Before and after aspiration, Dip time:0s
Rinse pump method:	Rinse port only, Time:2s     Rinse mode:     Before and after aspiration       Rinse dip time:     0

Pump Autosamplet Oven st	tem Controller	A AT Column Quer	
Column Oven		A: AE Column Oven	
Column Oven A		- Oven A - Advanced	
Oven temperature:	40 °C		
Temperature limit(Maximum):	105 °C		
Ready check:	On		
	Ready range:1.0°C	/ Wait for temperature equilibration before run	
L			
		wait time:	
		Ready range: 1.0 °C	
•	+ シリーズの場	ト バルブの設定を行います(Trainin	のでけ
) 7500 および 7500	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
) 7500 および 7500 図の通り入力します	)。		
) 7500 および 7500 図の通り入力します	), (		
) 7500 および 7500 図の通り入力します IntegratedSystem : ExionL	C Time (min)	Position	
)7500 および 7500 図の通り入力しまう IntegratedSystem : ExionL	C Time (min)	Position A	
)7500 および 7500 図の通り入力します IntegratedSystem : ExionL Valve : Valve Model	<ul> <li>Time (min)</li> <li>0</li> <li>0.05</li> </ul>	Position A B	

選択します。 ます(Training ven 2-Column Switching p time: xcentration A: ccentration A:
選択します。 ます(Training ven 2-Column Switching p time: *: ventration A: ventration B:
Lefult Simple Program p time: xcentration A: xcentration B:
Left (Training Ven 2-Column Switching Default Simple Program p time: ac: vcentration A: scentration B:
Default         Simple         Program           p time:         1.00         einut           xc         0.200         ml/m           ncentration A:         50.0         %           scentration B:         50.0         %
w: 0.200 mtl/n ncentration A: 50.0 % ncentration B: 50.0 %
ion of SSV A: A1
v vec no no
宦を行います。
<b>~</b>
ump* Autosampler
al settings
ampler:

Agiler	nt 社製 LC の場合】							
(1)	LC Pump : Binary Pu	np タブをクリ	ックしま	す。				
2	画面の左側に Pump の	パラメータ、オ	白側にタイ	イムテー	ブル	が表え	示される	ます。
3	流速、移動相組成は、実 0.2 mL/min 、Solvent	警察に使用する s に B 50 % を	組成、流〕 :入力)。	速を入力	」しま	す(Ti	raining	g では流速
	Flow	•		Advanced				
	0.200 -	mL/min		Timetable (3/69	events)			
	Solvents		Tim	ne [min]	Δ [%]	B [%]	Flow	Max. Pressure
	A: 50.0 %			0.00	50.0 50.0	) 50.0 ) 50.0	[mL/min] 9 0•30 0 0.20	Limit [bar] 0 400.00 0 400.00
	Pressure Limits							
	Min: 0.00 bar	Max: 400.00 🛟 t	ar					
	Stoptime Po	sttime						
	<ul> <li>As Injector/No Limit</li> <li>1.00 ; min</li> </ul>	Off     1.00	nin					
4	タイムテーブルにグラミ 1 分間)。	ジエント条件を	と入力しま	きす(Tra:	ining	; でに	13と同	司じ条件で
5	Column Oven : Colum (Training ではを 40℃と	Column Oven : Column Comp.タブをクリックし、Temperature を入力します (Training ではを 40℃と入力)。						
6	Autosampler : Sample	rタブをクリッ	ァクします	F <sub>o</sub>				
$\overline{O}$	Injection Volume(注入	量)を入力しま <sup>、</sup>	ナ(Traini	ngでは	10 µ	Lとフ	入力)。	
	Injection							
	Injection	i volume:	10.00 ‡	μ				
8	7500 および 7500 + ミ 下図の通り入力します) く	∕リーズの場合 。	、バルブ	の設定な	を行い	います	- (Tra	ining では
	IntegratedSystem : ExionLC	Time (min)	Position					
	Valve : Valve Model	0	A					
		0.05	B					
9	上部にある Save ボタン イル名を入力して保存し	への下矢印をク します(Trainin	リックし g では Re	て Save eserpine	as ? e_FL/	を選り <b>A</b> とノ	尺し、通 入力)。	<u></u> 箇当なファ

# FIA 用に作成したメソッドで機器を平衡化する

- ① LC のラインが MS に接続されていることを確認します。
- ② 標準溶液の入ったバイアルをオートサンプラーに置きます。
- Status Panel をクリックし、下部の Equilibrate アイコンを クリックします。



- ④ 作成した MS Method および LC Method をプルダウンより選択します。
  - ※ Training では下記のように選択します。
     MS Method : Reserpine\_FIA\_posi
     LC Method : Reserpine\_FIA

System Preparation	Х
Equilibrate	
MS Method Reserpine_FIA_pos	
LC Method Reserpine_FIA	
Time (min.)	
OK Cancel	

- ⑤ 平衡化する時間を入力し、OK をクリックします(Training では1分)。
  - ※ イオンソース全体の温度が平衡になるのに 10 分程度かかりますので、15 分以上 を推奨します。その後、FIA による最適化を始めます。
  - ※ LC の溶媒が流れ、ガスやターボガスの加熱が始まり、平衡化後に画面右上の Status Panel が @ Ready に変わります。

_/1	TA IC A	014/	7-70	ノ日動取	: 1016	のほ	RYA'				
1	Home Ī	画面の M	S Metho	od アイ	コンな	をク	リックし	<i>、</i> ます。			
2	上部にお	ある New	の下矢	印(右図	参照)	をク	リックト	します。	MS Method		
3	Guided	l Optimiz	ation を	選択し	MF	RM	FIA を選	<b>観</b> 沢しま	:す。	New Ope	n 👻 Vie
4	測定条	件を入力・	する画面	が開き	ます。					Neutral Loss Precursor Ion	
	Set Ini	itial Acquis	ition Valu	es						Product Ion	
	Provide	e initial acquis	ition metho	d settings t	to use ir	n obta	aining initial	LC-MS co	nd	Q1 Q1 MI	
	LC Meth	hod	Reserpine_	FIA		<b>~</b> [	DLC Me	ethod を	:選択	Q3	
	Injection	n volume	0	<b>‡</b> μL						IDA	
	Method	duration 1		🗘 mir	1					Guided Optimization 🔸	MRM Infusion
	Rack Ty	pe 🚺	/ial Rack			•	Rack Typ	pe を選	択		MRM FIA
	Rack Po	sition				•					MS <sup>a</sup> Infusion
	Plate Ty	pe 1	.5mL Cooled	(70 vial)		•	Plate Ty	pe を選	禄		
	Plate Po	sition				•					
	Polarity	P	ositive			•					
		Compound ID	Q1 mass (Da)	Q3 mass (Da)	CE (V)	CXP (V)	Dwell time (ms)	Vial Position	Infus	ion での最適化	で取得
	1	Reserpine 1	609.000	397.000	38.0	21.0	100.0	1	したI	MRM を入力	

- ⑤ 使用する LC Method を選択します(Training では Reserpine\_FIA を選択)。
   ※ LC Method アイコン をクリックすると LC 条件を確認できます。
- ⑥ Rack Type および Plate Type を選択し、Injection volume、Method duration、Polarity に間違いがないかを確認します。
  - ※ Injection Volume は Method の設定値が採用されます。
  - ※ 上図は一例のため、LCの構成により Rack Type ならびに Rack Position、Plate Type、Plate Position を選択します。
- ⑦ Infusion 最適化で取得した MRM 情報を入力します(Training では1つを入力)。
  - ※ 最大 10 までで実施します。

「DIA」アトスノナンバーマの白動具海ルの開始

- ※ Excel で編集したものをコピー&ペーストして入力することも可能です。
- ※ Dwell time は 100 ms とします(デフォルト設定)。
- ⑧ セットしたバイアル位置を入力します(Training では Vial Position は1を入力)。

# 【注意】

行ごとにバイアルポジションを変えると各行に対して最適化を実施するため、 最適化が終了した後、複数のメソッドに分かれます。

- ⑨ Next をクリックし、次の画面に進みます。
- ⑩ FIA 最適化で使用する MS の初期パラメータを入力します。
- ① Source and Gas Parameters に下記の初期パラメータを入力します。

Set the initial LC-MS conditions to be used in the optimization step, by testing with different parameter values per compound.

Initial conditions with	Reserpine 💙	•	Vial position:	1				
	初刻	朝パラメ	ータ入力					
Source and Gas Paran	neters —							
lon source gas 1	50	psi	Curtain gas	40	psi	Source temperature	400	<b>≎</b> °C
lon source gas 2	60	psi	CAD gas	9	\$	Spray voltage	5500	<b>\$</b> v
• MRM								
Declustering potential	60	V	Collision energy	30	<b>\$</b> V	Collision cell exit potential	10	<b>\$</b> V
Q1 resolution	Unit 💉	•	Q3 resolution	Unit	•			

<FIA 最適化のイオンソースのパラメータ初期値>

4500 シリーズ、5500 および 5500+ シリーズ、6500 および 6500+ シリーズ

	設定範囲	TurboIonSpray (200 μL/min, FIA)	Heated Nebulizer (1000 µL/min,FIA)
Ion Source GS1	0~80	50	50
Ion Source GS2	0~80	60	N/A
Curtain Gas	$30 \sim 50$	40	40
CAD Gas	0 <b>~</b> 12	9	9
Source temperature	0 <b>~</b> 700	400	400
Spray Voltage	0~5500	5500 (4500)	-
Nebulizer current	$0\sim 5$	-	2 (2)

<sup>7500</sup> および 7500+ シリーズ

	設定範囲	OptiFlow®Pro (E-ANALYT 200+ μL:ESI) (200 μL/min, FIA)	OptiFlow®Pro (APCI) (1000 µL/min,FIA)
Ion Source GS1	0~80	50	50
Ion Source GS2	0~80	60	N/A
Curtain Gas	$30 \sim 50$	40	40
CAD Gas	0 <b>~</b> 15	9	9
Source temperature	0~700	400	400
Spray Voltage	0~5500	5500(4500)	-
Nebulizer current	0~5	-	2 (2)

※ カッコ()内は Negative モード時の設定値を表します。

※ Negative の IS は最大 4500 です。

※ CURの推奨値は 40 以上です。感度が十分な場合は 40 に設定して下さい。

※ TIS の設定温度(Temperature)は最大 700℃までにしてください。 750℃でも使用できますが、ヒーターの寿命が短くなりますので推奨しません。

- 12 上部の Next ボタンをクリックします。
- ③ イオンソースパラメータの検討方法を設定します(Training では Range および Intensityを選択)。
  - ※ パラメータの振り方は範囲指定(Range)と値指定(Discrete)があります。
  - ※ 最適化の指標は強度(Intensity)と S/N(Signal To Noise)があります。

Determine step size using	Range 💉	Optimize using	Intensity
Initial Parameter Values	Range		Intensity
Optimize Parameter Na	Discrete	Start Stop	Signal To Noise

- ④ 下記のようにイオンソースパラメータの検討範囲を設定し、Start ボタンをクリックします。
  - 1) 最適化するパラメータは、Optimize にチェックを入れます。
  - Infusion での最適化を Training では実施しているため、DP および CE、CXP を最 適化しない場合はチェックを外します(7500 および 7500+ シリーズの場合は、DP の項目はありません)。
  - 4500 シリーズ、5500 および 5500+シリーズ、6500 および 6500+シリーズの参考値 Initial Parameter Values

Optimize	Parameter Name	Initial Value	Start	Stop	Step
	DP (v)	Show all	80	120	20
	CE (v)	Show all	20	30	5
	CXP (v)	Show all	5	15	5
✓	Curtain Gas (psi)	40.0	30	45	5
<	CAD Gas	9.0	6	12	1
<	Spray Voltage (V)	5500.0	4500	5500	500
✓	Source temperature (°C)	400.0	300	700	50
✓	Ion Source Gas1 (psi)	50.0	20	80	10
<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	Ion Source Gas2 (psi)	60.0	20	80	10

7500 および 7500+ シリーズの参考値 Initial Parameter Values

			<b>.</b>	<i>c</i> .	<i>c</i> .
Optimize	Parameter Name	Initial Value	Start	Stop	Step
	CE (v)	Show all	20	50	10
	CXP (v)	Show all	5	15	5
<	Curtain Gas (psi)	40.0	40	50	5
<	CAD Gas	9.0	6	15	1
<	Spray Voltage (V)	5500.0	1500	5500	500
<	Source temperature (°C)	0.0	250	700	50
<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	Ion Source Gas1 (psi)	35.0	20	80	10
<ul><li>✓</li></ul>	Ion Source Gas2 (psi)	70.0	20	80	10

- ※ Negative の IS は最大 4500 です。
- ※ 設定温度(Temperature)は最大 700℃までにしてください。 750℃でも使用できますが、ヒーターの寿命が短くなりますので推奨しません。

- 3) Infusion での最適化した項目以外のパラメータは、1条件につき1注入です。
- 4) 注入する回数の合計は、右下の Sample injections に表示されます。
  - ※ 1 注入が 10 μL で注入回数が 20 回の場合、溶液は合計で 200 μL 使用し ます。
  - ※ 下の例は 20 本中 13 条件目を測定中、合計 200 µL 使用する場合の表示

Sample injections: 13 20 Total sample volume: 200 µL

- 5) 複数回での結果を反映させる場合は、Replicate injection for each step をプル ダウンすると選択可能です。
- 15 Sample injections が 0/【注入回数】になったら、Next ボタンをクリックします。
- 16 結果レポート画面が出力されます。
  - ※ レポートは測定データとともに自動で下記フォルダ内に保存されます。
  - <SCIEX OS3.4 未満>

D:\SCIEX OS Data\Optimization \FIAOptimization-【测定日時】

<SCIEX OS3.4 以上>

D:\SCIEX OS Data\[Project 名] \Optimization \FIAOptimization-【测定日時】

- ⑦ 右上の Open in MS Method Editor ボタンから最適化された MS メソッドを確認する ことができます。
  - ※ 最適化が完了した MS メソッドは下記フォルダに自動で保存されます。

D:\SCIEX OS Data\ [Project 名] \ Acquisition Method\FIA - 【測定日時】

- 4.7 測定メソッド(Acquisition Method)の完成(MS Method)
- Open in MS Method Editor をクリックして開いた MS Method または Home 画面から MS Method をクリックして、FIA で最適化した MS メソッドを上部にある Open から 選択して開きます。
- ② メソッドに測定時間を入力します(Training では6分と入力)。
  - ※ LCの測定時間が既知の場合は、Method duration にその時間を入力します。
- ③ Total scan time を確認しながら Dwell Time を調整します。
  - ※ 参考(Dwell time について)

Time に Dwell Time を入力する際、Total scan time が十分か確認します。

Dwell Time はクロマトグラムにおけるピークの溶出幅とデータポイント数から換算して設定します。



④ 上部の Save ボタンの下矢印から Save as で名前をつけて、保存します(Training では Reserpine\_MRM を入力)。

- 4.8 測定メソッド(Acquisition Method)の完成(LC Method)
  - ※ 実際の測定に使用する測定メソッドを作成します。
- ① Home 画面の LC Method アイコンをクリックします。
- 上部にある Open をクリックし、LC メソッドを選択します(Training では Reserpine\_FIAを選択)。
- ③ 以降の各 LC の入力方法を参考に LC 条件を入力します(Training では以下の条件を使用)。

流速:0.2 mL/min、Gradient 条件:下図、Injection Volume:5 µL

	Time	Flow	A.Conc	B.Conc
1	•	0.2000	90.0	10.0
2	3.00	0.2000	10.0	90.0
3	3.01	0.2000	90.0	10.0
4	6.00	0.2000	90.0	10.0

MOULO,	島津社製 LC の場	拾】					
Din arra (	Inadiant なづたれ川	い クレナナ					
Dinary G	radient タノをクリ	ツクしまり。	0				
メソッド	上部にある Injectio	n Volume K	注入量を	入力します	ナ。		
Stop Tim	ne に 6.0 min、Flow	v(流速) 、B	B Conc.に適	i当な値を	入力し	、ます。	
-							
	sampler Oven OV Detector Syste	micontroller					
B.(	351						
Ston time:	6.00 min		r Gradient				
stop time.	6.00 min		Advanced (	Simple			
B.Conc	A.Conc		Time	Flow A	.Conc B.G	onc	
100			1	0.2000	50.0	50.0	
80			2 0.50	0.2000	50.0	50.0	
60			3 2.50	0.2000	20.0	80.0	
40			4 4.00	0.2000	20.0	50.0	
20			6 6.00	0.2000	50.0	50.0	
0 0.00	1.20 2.40 3.60	4.80 6.00	7				
	min		Mohile phase swi	tching value			
Flow	0.2000 ml/min		- Mobile phase swi	inas			
Time to rea	ch the flow 0.00 min (Off		Pump A				
A Const		b.	Compressibility se	ttings			
A.Conc:	50.0 %		Mobile phase	name	Compressibi	lity	
B.Conc:	50.0 %		A: Mobile phase	A	0.45 /G	Pa	
Minimum:	0.0 MPa Maximum: 40.0 MP	a	Pump B				
Autosam	pler タブをクリッ:	クします。					
		- <sup>2</sup> 1 2	の沢広と「	1 - 1 - 2 - 2	L-		
Cooler te	mperature にサン	ノルクーラー	-の温度を/	へ力しまう	9 o		
Rinse Se	ettings の Rinse M	Iode を Be	fore and a	after asp	iratio	n に、』	<b>公要に応じて</b>
Rinsing	Volume, Rinse Me	thod を入力	します。	F			
			0 0 0				
8							
Pump Autosampi	er Oven System Controller						
Pump Autosample AE Auto	er Oven System Controller osampler	Direct injection					
Pump Autosampl	er Oven System Controller osampler	Direct injection	nc				
Pump Autosample AE Auto	er Oven System Controller osampler	Sample plate setting	gs				÷ ≫ Tin
Pump Autosampl	er Oven System Controller osampler	Direct injection Sample plate setting Specify plate Specify needle s	gs				≫ Time pro
Autosample Autosampler Autosampler Injection settings Sampling speed:	er Oven System Controller osampler 5.0 µL/s	Direct injection Sample plate setting Specify plate Specify needle s	gs	Needle Strok	e *		≫ Time program ≫ Pretrootment
Pump Autosampl AE Auto Autosampler Injection settings Sampling speed: Cooler temper	er Oven System Controller osampler 5.0 µL/s ature: 15 C	Direct injection	gs Stoke	Needle Strok [mm]	e 🔺		≫ Time grogram ≫ Pratropriment
Pump Autosample AE Autos Nettosampler Injection settings Sampling speed: Cooler tempen	er Oven System Controller osampler 5.0 µL/s ature: 15 C	Direct injection  Sample plate setting  Specify plate  Specify needle s  Plate	gs droke	Needle Strok [mm]	e *		≫ Time program ≫ Pretradiment
Pump Autosampl Autosampler Autosampler Injection settings Sampling speed: Cooler temper Rinse settings — Rinse type	er Oven System Controller osampler ature: 5.0 µL/s External only v	Direct injection  Sample plate setting  Specify plate  Specify needle s  Plate Iml, 1, Saul	gs drok <u>e</u> ] Type	Needle Strok [mm]	e 47.0		≫ Time program Pretradment
Pump Autosampl AE Auto Autosampler Injection settings Sampling speed: Cooler tempen Rinse settings Rinse type	er Oven System Controller osampler ature: 5.0 µL/s ature: 15 °C External only Refer flow channels.	Direct injection  Sample plate setting  Specify plate  Specify needle s  State  Imi,  1.5mi,  4mi,	gs troke	Needle Strok [mm]	e 47.0 47.0 47.0		> Time grogram
Pump Autosampl Autosampler Injection settings Sampling speed: ✓ Cooler temperi Rinse settings Rinse type	er Oven System Controller osampler ature: 5.0 µL/s to 15 °C External only Refer flow channels	Direct injection  Sample plate setting  Specify plate  Specify needle s  Flate  TmL  1.5mL  4mL  10mL	gs troke ] Type	Needle Strok [mm]	e 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0		> Time program
Pump Autosampl Autosampler Injection settings Sampling speed: Cooler temper Rinse settings Rinse type External Rinse mode	er Oven System Controller osampler	Direct injection  Sample plate setting  Specify plate  Plate  Plate  Plate  ImL  1.5mL  4mL  10mL  MTP 96	gs broke	Needie Strok [mm]	e 47.0 47.0 47.0 47.0 48.0		≫ Time program ≫ Pretradiment
Pump Autosampl Autosampler Injection settings Sampling speed: Cooler temper Rinse settings Rinse type External Rinse mode:	er Oven System Controller osampler	Direct injection  Sample plate setting  Specify plate  Plate  Plate  Tml,  1.5mL  4mL  10mL  MTP 96  DVP 96  MTP 204	gs droke	Needle Strok [mm]	e 47.0 47.0 47.0 47.0 48.0 48.0		≫ Time program
Pump Autosample ALTOSAMPLE ALTOSAMPLE Injection settings Sampling speed: ✓ Cooler tempen Rinse settings Rinse type: External Rinse mode:	er Oven System Controller osampler ature: 5.0 µL/s ature: 15 °C External only Refer flow channels Before and after aspiration Dip time.0s Rinse port only	Direct injection  Sample plate setting  Specify plate  Specify needle s  Fisze Tml, 1.5mL 4mL 10mL MTP 96 DWP 96 MTP 384 maxn 264	gs troke	Needle Strok [mm]	e 47.0 47.0 47.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0		≈ Fretradment
Pump Autosampl Autosampler Injection settings Sampling speed: Cooler tempera Rinse settings — Rinse type: External Rinse mode: Rinse method:	er Oven System Controller osampler ature: 5.0 µL/s ature: 15 °C External only v Refer flow channels Before and after aspiration Dip time.0s v Rinse port only Time2.0s v	Direct injection  Sample plate setting  Specify plate  Specify needle s  State ImL 1.5mL 4mL 10mL MTP 96 DWP 96 MTP 384 ream 204 -Injection settings -	gs troke ] Type	Needle Strok [mm]	e 47.0 47.0 47.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0		> Fretradment

6 Ove	en タブをクリックします。			
⑦ Ove	en temperature に温度を入力しま	す。		
⑧ Inje	ection をクリックし注入量を入力	します。		
*	Injection Volume はサンプルル	ープの容量以上入	力しないでくだ	さい。
	Injection Volume			
	Pump Autosampler Oven System Controller			
	Column Oven	A: AE Column Oven		
	Column Oven A	- Oven A - Advance	i	* - »
	Oven temperature: 40 °C			ime pr
	Ready check: On			gram
	Wait time:Smin Ready range:1.0°C	✓ Wait for temperature e	quilibration before run	
		Wait time:	5 n	in
		Ready range:	1.0 *	c i
	「にたいていいづの訊合たにいます		Time (min)	Position
<ol> <li>9 必要</li> <li>右記</li> </ol>	そに応してハルノの設定を行います この通り入力)。	(Training Cit	0.1	В
			5.5	A
※ 参	考(バルブの設定)			
通常の	設定の場合、	Pump In	Pump In	
6 方バ	ルブは			Bource
Pos	ition A ( 廃液 ) : 6-1, 2-3, 4-5	Waste <b>T</b>		3
Pos	ition B (MS) : 1-2, 3-4, 5-6			
がつた	こがっています。 、 訊字になっていて担合すまります			1117 ふ、ナ. デルテヨ
お外なる の上	、設定になっている場合もめりまり ご 体田ください	ので、との番号の	リホートから彼か	山るがをこ帷祕
<u>у</u> т.,				
【注意	]			
Valv	e の切り替え時間は、MS の測定	開始時間および終	了時間と同じ時	間設定にしない
でく	ださい。			
例)0	~6 分の分析の場合、0.5~5.5 分の	の間で切り替え時間	間を設定します。	
10 上音	『にある Save ボタンの下矢印をク	リックし Save as	を選択し、適当	なファイル名を
入力	」して保存します(Training では Re	eserpine_MRM と	:入力)。	

) Binary Gradi し グラジエ	ent タブをクリ ント条件を設定	ックし、Flow ミレます	program を	Simple ±7	CIA Frogram ?	を選択
<ul> <li>Flow progra</li> </ul>	m —					
			t Simple	Drogram		
A .	1	Delaul		Program		
80 %		Use equili	bration:			
60 % 40 %		Tim	e (min) Flow (m	nL/min) A (%)	B (%) Event	
20 %		1 0.00	0.200	\$ 50.0	50.0 🗘 00000000	
0.00 0.80	1.60 2.40 3.2 Time (min)	0 4.00 2 1.00	0.200	\$ 50.0	50.0 🗘 0000000	
	nine (nin)	3 2.00	0.200	\$ 20.0 \$	80.0 🗘 00000000	
		4 3.00	0.200	20.0 🗘	80.0 🗘 00000000	
		5 3.10	0.200	\$ 50.0 \$	50.0 🗘 00000000	
		6 4.0	0.200	\$ 50.0	50.0 2 0000000	
					G	
= Conoral cott						
• General sell			-			
Pressure minimum:	o ^	bar Position of S	SSV A:	A1 💙		
Pressure maximum:	350 🗘	bar Position of	SSV B:	B1 💙		
) General setti ) Autosampler に回を入れ、 rinse steps よ Bipary Pump*	ngs では使用 <sup></sup> タブをクリック Advanced sett りループ洗浄の uutosampler*_ Colu	するカラムの耐 クし、Injection tings の・をクリ の設定を行いま umn Oven 2-Colum	圧、溶媒切り volumeを リックし下図 す(下図右)。	り替えバルコ 入力、Use t 【左のように	ブの設定を行い tray thermost こ設定し、Adv	ます。 atting anced
) General setti ) Autosampler に回を入れ、 rinse steps よ Binary Pump*	ngs では使用 <sup>-</sup> タブをクリック Advanced sett りループ洗浄の Autosampler* Colu	するカラムの耐 クし、Injection tings の・をクリ の設定を行いま umn Oven 2-Colun	圧、溶媒切り volume を リックし下図 す(下図右)。 nn Switching	り替えバルコ 入力、Use t 国左のように	ブの設定を行い tray thermost こ設定し、Adv	ます。 atting anced
) General setti ) Autosampler に☑を入れ、 rinse steps よ Binary Pump* 4 • General setting	ngs では使用 <sup>-</sup> タブをクリック Advanced sett りループ洗浄の Autosampler* Colu	するカラムの耐 クし、Injection tings の・をクリ の設定を行いま umn Oven 2-Colun	圧、溶媒切り volume を リックし下図 す(下図右)。 nn Switching	り替えバルコ 入力、Use t 【左のように	ブの設定を行い tray thermost こ設定し、Adv	ます。 atting anced
) General setti ) Autosampler に⊇を入れ、 rinse steps よ Binary Pump* General setting Use autosampler.	ngs では使用 <sup>-</sup> タブをクリック Advanced sett りループ洗浄の Autosampler* Colu	するカラムの耐 クし、Injection tings の・をクリ の設定を行いま umn Oven 2-Colum	圧、溶媒切り volume を リックし下図 す(下図右)。 nn Switching	り替えバルコ 入力、Use t 【左のように	ブの設定を行い tray thermost こ設定し、Adv	ます。 atting anced
) General setti Autosampler に回を入れ、 rinse steps よ Binary Pump* General setting Use autosampler. Injection volume: Binse mode	ngs では使用 <sup>-</sup> タブをクリック Advanced sett りループ洗浄の Autosampler* Colu	するカラムの耐 クし、Injection tings の・をクリ の設定を行いま umn Oven 2-Colun Use air gap:	圧、溶媒切り volume を リックし下図 す(下図右)。 nn Switching	り替えバルコ 入力、Use t 国左のように	ブの設定を行い tray thermost こ設定し、Adv	ます。 atting anced
<ul> <li>General setti</li> <li>Autosampler</li> <li>に ●を入れ、</li> <li>rinse steps よ</li> <li>Binary Pump*</li> <li>General setting</li> <li>Use autosampler:</li> <li>Injection volume:</li> <li>Rinse mode:</li> <li>Advanced rinse steps:</li> </ul>	ngs では使用 <sup>-</sup> タブをクリック Advanced sett りループ洗浄の Autosampler* Colu s	するカラムの耐 クし、Injection tings の・をクリ の設定を行いま umn Oven 2-Colun Use air gap: Use headspace pressure Use tray thermostatting	圧、溶媒切り volumeを リックし下図 す(下図右)。 m Switching	り替えバルコ 入力、Use t 国左のように	ブの設定を行い tray thermost こ設定し、Adv	ます。 atting anced
<ul> <li>General setti</li> <li>Autosampler</li> <li>Autosampler</li> <li>レクタンれ、</li> <li>rinse steps よ</li> <li>Binary Pump*</li> <li>General setting</li> <li>Use autosampler:</li> <li>Injection volume:</li> <li>Rinse mode:</li> <li>Advanced rinse steps:</li> </ul>	ngs では使用 <sup>-</sup> タブをクリック Advanced sett りループ洗浄の Autosampler* Colu s	するカラムの耐 クし、Injection tings の・をクリ の設定を行いま umn Oven 2-Colun Use air gap: Use headspace pressure Use tray thermostatting Temperature:	圧、溶媒切り volumeを リックし下図 す(下図右)。 nn Switching	り替えバルコ 入力、Use t 全のようは ExionLC2 Rinse steps:	ブの設定を行い tray thermost こ設定し、Adv .0 - Advanced rinse steps : 3	ます。 atting anced
) General setti Autosampler に回を入れ、 rinse steps よ Binary Pump* General setting Use autosampler: Injection volume: Rinse mode: Advanced rinse steps:	ngs では使用 タブをクリック Advanced sett りループ洗浄の Autosampler* Colu s	するカラムの耐 クし、Injection tings の・をクリ の設定を行いま umn Oven 2-Colun Use air gap: Use headspace pressure Use tray thermostatting Temperature:	圧、溶媒切り volumeを リックし下図 す(下図右)。 m Switching	り替えバルフ 入力、Use t 全のように ExionLC2 Rinse steps: Rinse delay	ブの設定を行い tray thermost こ設定し、Adv .0 - Advanced rinse steps : 3 (min): 0.0	ます。 atting anced
<ul> <li>General setti</li> <li>Autosampler</li> <li>た ○を入れ、</li> <li>rinse steps よ</li> <li>Binary Pump*</li> <li>General setting</li> <li>Use autosampler:</li> <li>Injection volume:</li> <li>Rinse mode:</li> <li>Advanced rinse steps:</li> <li>Rack settings =</li> </ul>	ngs では使用 タブをクリック Advanced sett りループ洗浄の Advanced colu s	するカラムの耐 クし、Injection tings の・をクリ の設定を行いま umn Oven 2-Colun Use air gap: Use headspace pressure Use tray thermostatting Temperature:	E、溶媒切り volumeを リックし下図 す(下図右)。 m Switching	り替えバルン 入力、Use t 全のように ExionLC2 Rinse delay Please note	ブの設定を行い tray thermost こ設定し、Adv .0-Advanced rinse steps : 3 (min): 0.0 : that the last step must be T	ます。 atting anced
<ul> <li>General setti</li> <li>Autosampler</li> <li>Autosampler</li> <li>に 2を入れ、</li> <li>rinse steps よ</li> <li>Binary Pump*</li> <li>General setting</li> <li>Use autosampler:</li> <li>Injection volume:</li> <li>Rinse mode:</li> <li>Advanced rinse steps:</li> <li>Rack settings -</li> <li>Rack</li> <li>2x 48 vial rack</li> </ul>	ngs では使用 タブをクリック Advanced sett りループ洗浄の Autosampler* Colu s 2000 µL Advanced v Setup	するカラムの耐 クし、Injection tings の・をクリ の設定を行いま umn Oven 2-Colun Use air gap: Use headspace pressure Use tray thermostatting Temperature:	圧、溶媒切り volumeを リックし下図 す(下図右)。 nn Switching	り替えバルフ 入力、Use t 全のようは ExionLC2 Rinse steps: Rinse delay Please note the µL pick	ブの設定を行い tray thermost こ設定し、Adv .0 - Advanced rinse steps : 3 (min): 0.0 : that the last step must be T up plus injection mode is use	ます。 atting anced
) General setti Autosampler に回を入れ、 rinse steps よ Binary Pump* A General setting Use autosampler: Injection volume: Rinse mode: Advanced rinse steps: Rack 2x 48 vial rack 2x 96 deep-well plate	ngs では使用 タブをクリック Advanced sett りループ洗浄の Autosampler* Colu s <u>20.0</u> µL Advanced v Setup	するカラムの耐 クし、Injection tings の・をクリ の設定を行いま umn Oven 2-Colun Use air gap: Use headspace pressure Use tray thermostatting Temperature: Plate process order: R Use a specific rack: Use pretreatment:	圧、溶媒切り volumeを リックし下図 す(下図右)。 m Switching	り替えバルフ 入力、Use t 全のようは たのようは Rinse steps: Rinse delay Please note the µL picku	ブの設定を行い tray thermost こ設定し、Adv こ設定し、Adv	ます。 atting anced
<ul> <li>General setti</li> <li>Autosampler に ● を入れ、 rinse steps よ</li> <li>Binary Pump*</li> <li>General setting</li> <li>Use autosampler: Injection volume: Rinse mode: Advanced rinse steps:</li> <li>Rack settings = Rack 2x 48 vial rack 2x 96 deep-well plate 2x 96 well plate</li> </ul>	ngs では使用 タブをクリック Advanced sett りループ洗浄の Autosampler* Colu s <u>200 ↓</u> µL Advanced ▼ <u>Setup</u>	するカラムの耐 クし、Injection tings の・をクリ の設定を行いま umn Oven 2-Colun Use air gap: Use headspace pressure Use tray thermostatting Temperature:	圧、溶媒切り volumeを リックし下図 す(下図右)。 m Switching	り替えバルン 入力、Use t 」 たのように Rinse steps: Rinse delay Please note the µL pickt	ブの設定を行い tray thermost こ設定し、Adv .0 - Advanced rinse steps : 3 (min): 0.0 : that the last step must be T up plus injection mode is us sosition Volume (µL) 「500	ます。 atting anced
<ul> <li>General setti</li> <li>Autosampler に反を入れ、 rinse steps よ</li> <li>Binary Pump*</li> <li>General setting</li> <li>Use autosampler: Injection volume: Rinse mode: Advanced rinse steps:</li> <li>Rack settings - Rack 2x 48 vial rack 2x 96 deep-well plate 2x 96 well plate 2x 96 well plate</li> </ul>	ngs では使用 タブをクリック Advanced sett りループ洗浄の Autosampler* Colu s 20.0 ♀ µL Advanced ▼ Setup	するカラムの耐 クし、Injection tings の・をクリ の設定を行いま USE air gap: USE headspace pressure USE tray thermostatting Temperature: Plate process order: R USE a specific rack: USE pretreatment: USE stacked injections: こ	圧、溶媒切り volumeを リックし下図 す(下図右)。 nn Switching	り替えバルン 入力、Use t 」 左のように 「The stime steps: Rinse steps: Rinse delay Please note the µL picku Please note the µL picku 2 Transp	ブの設定を行い tray thermost こ設定し、Adv .0 - Advanced rinse steps : 3 (min): 0.0 : that the last step must be T up plus injection mode is us: ssition Volume (µL) 「500 xort 「750	ます。 atting anced
<ul> <li>General setti</li> <li>Autosampler</li> <li>Autosampler</li> <li>C 夕 入れ、</li> <li>rinse steps よ</li> <li>Binary Pump*</li> <li>General setting</li> <li>Use autosampler:</li> <li>Injection volume:</li> <li>Rinse mode:</li> <li>Advanced rinse steps:</li> <li>Rack</li> <li>2x 48 vial rack</li> <li>2x 96 deep-well plate</li> <li>2x 36 well plate</li> <li>2x 384 well plate</li> <li>108 vial rack</li> </ul>	ngs では使用 タブをクリック Advanced sett りループ洗浄の Autosampler* Colu s <u>20.0</u> µL Advanced v Setup	するカラムの耐 クし、Injection tings の・をクリ の設定を行いま umn Oven 2-Colun Use air gap: Use headspace pressure Use tray thermostatting Temperature: Plate process order: R Use a specific rack: Use pretreatment: Use stacked injections: 「	圧、溶媒切り volumeを リックし下図 す(下図右)。 m Switching	り替えバルフ 入力、Use t 全のようは たのようは Rinse steps: Rinse delay Please note the µL picku Pc 1 Wash 2 Transp 3 Transp	ブの設定を行い tray thermost こ設定し、Adv .0 - Advanced rinse steps : 3 (min): 0.0 that the last step must be T up plus injection mode is us sosition Volume (µL) くのの xort く 1000	ます。 atting anced
<ul> <li>General setti</li> <li>Autosampler に回を入れ、 rinse steps よ</li> <li>Binary Pump*</li> <li>General setting</li> <li>Use autosampler: Injection volume: Rinse mode: Advanced rinse steps:</li> <li>Rack settings - Rack 2x 48 vial rack 2x 96 deep-well plate 2x 96 well plate</li> <li>2x 48 vial rack</li> <li>2x 49 vial rack</li> <li>2x 12 vial rack</li> </ul>	ngs では使用 タブをクリック Advanced sett りループ洗浄の Autosampler* Colu S S 200 ↓ μL Advanced ↓ Setup	するカラムの耐 クし、Injection tings の・をクリ の設定を行いま umn Oven 2-Colun Use air gap: Use headspace pressure Use tray thermostatting Temperature: Plate process order: R Use a specific rack: Use pretreatment: Use stacked injections: こ	圧、溶媒切り volumeを リックし下図 す(下図右)。 m Switching	り替えバルフ 入力、Use t 」 左のようは	ブの設定を行い tray thermost こ設定し、Adv この - Advanced rinse steps : 3 (min): 0.0 that the last step must be T up plus injection mode is us sistion Volume (µL) soti v 750 sort v 750	ます。 atting anced
<ul> <li>General setti</li> <li>Autosampler に反を入れ、 rinse steps よ</li> <li>Binary Pump*</li> <li>General setting</li> <li>General setting</li> <li>General setting</li> <li>Use autosampler: Injection volume: Rinse mode: Advanced rinse steps:</li> <li>Rack settings - Rack</li> <li>2x 48 vial rack</li> <li>2x 96 deep-well plate</li> <li>2x 96 vell plate</li> <li>2x 96 vell plate</li> <li>2x 96 vell plate</li> <li>108 vial rack</li> <li>2x 12 vial rack</li> <li>30 vial rack</li> </ul>	ngs では使用 タブをクリック Advanced sett りループ洗浄の Autosampler* Colu s 20.0 ・ µL Advanced ・ Setup	するカラムの耐 クし、Injection tings の・をクリ の設定を行いま umn Oven 2-Colun Use air gap: Use headspace pressure Use tray thermostatting Temperature:	圧、溶媒切り volume を リックし下図 す(下図右)。 nn Switching	り 替えバルコ 入力、Use t 」 左のように Rinse steps: Rinse delay Please note the µL picku Please note the µL picku 2 Transp 3 Transp	ブの設定を行い tray thermost こ設定し、Adv この-Advanced rinse steps : 3 (min): 0.0 : that the last step must be T up plus injection mode is us sosition Volume (µL) ッ 500 sort マ 750 sort マ 1000	ます。 atting anced
<ul> <li>General setti</li> <li>Autosampler に反を入れ、 rinse steps よ</li> <li>Binary Pump*</li> <li>General setting</li> <li>Use autosampler: Injection volume: Rinse mode: Advanced rinse steps:</li> <li>Rack settings - Rack</li> <li>2x 48 vial rack</li> <li>2x 96 deep-well plate</li> <li>2x 48 vial rack</li> <li>2x 96 deep-well plate</li> <li>2x 96 vell plate</li> <li>2x 96 vell plate</li> <li>2x 12 vial rack</li> <li>30 vial rack</li> <li>x Advanced settil</li> </ul>	ngs では使用 タブをクリック Advanced sett りループ洗浄の Autosampler* Colu s 200 µL Advanced v Setup	するカラムの耐 クし、Injection tings の・をクリ の設定を行いま umn Oven 2-Colun Use air gap: Use headspace pressure Use tray thermostatting Temperature: Plate process order: R Use a specific rack: Use pretreatment: Use stacked injections: ()	E、溶媒切り volumeを リックし下図 す(下図右)。 m Switching	り替えバルフ 入力、Use t 」 左のようは Rinse steps: Rinse delay Please note the µL picku Pc 1 Wash 2 Transp 3 Transp	ブの設定を行い tray thermost こ設定し、Adv .0 - Advanced rinse steps : 3 (min): 0.0 that the last step must be T up plus injection mode is us sistion Volume (µL) 「SOO sort 『750 sort 『750	ます。 atting anced
<ul> <li>General setti</li> <li>Autosampler に ひを入れ、 rinse steps よ</li> <li>Binary Pump*</li> <li>General setting</li> <li>Use autosampler: Injection volume: Rinse mode: Advanced rinse steps:</li> <li>Rack settings - Rack 2x 48 vial rack 2x 96 deep-well plate 2x 96 deep-well plate 2x 96 well plate</li> <li>2x 48 vial rack 2x 12 vial rack</li> <li>30 vial rack</li> <li>× Advanced setti Syringe speed:</li> </ul>	ngs では使用 タブをクリック Advanced sett りループ洗浄の Advanced sett りループ洗浄の Setup	するカラムの耐 クし、Injection tings の・をクリ の設定を行いま umn Oven 2-Colun Use air gap: Use headspace pressure Use tray thermostatting Temperature: Plate process order: Use a specific rack: Use pretreatment: Use stacked injections:	E、溶媒切り volumeを リックし下図 す(下図右)。 m Switching	り替えバルフ 入力、Use t 」 左のようは 「「ExionLC2 Rinse delay Please note the µL pick 1 Wash 2 Transp 3 Transp	ブの設定を行い tray thermost こ設定し、Adv この - Advanced rinse steps : 3 (min): 0.0 * that the last step must be T up plus injection mode is us sistion Volume (µL) * 500 sort * 750 sort * 1000	ます。 atting anced
<ul> <li>General setti</li> <li>Autosampler に」を入れ、 rinse steps よ</li> <li>Binary Pump*</li> <li>General setting</li> <li>General setting</li> <li>General setting</li> <li>Use autosampler: Injection volume: Rinse mode: Advanced rinse steps:</li> <li>Rack settings - Rack</li> <li>2x 48 vial rack</li> <li>2x 96 deep-well plate</li> <li>2x 96 vell plate</li> <li>2x 96 vell plate</li> <li>108 vial rack</li> <li>2x 12 vial rack</li> <li>30 vial rack</li> <li>Charack setting</li> <li>Syringe speed: Syringe speed:</li> </ul>	ngs では使用 タブをクリック Advanced sett りループ洗浄の Advanced sett りループ洗浄の S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	するカラムの耐 クし、Injection tings の・をクリ の設定を行いま umn Oven 2-Colun Use air gap: Use headspace pressure Use tray thermostatting Temperature: Plate process order: R Use a specific rack: Use Use pretreatment: Use stacked injections: Use stacked injections: Injection method: This injection moder req	E、溶媒切り volume を リックし下図 す(下図右)。 nn Switching	り替えバルン 入力、Use t 」 たのように Rinse delay Please note the µL picku 2 Transp 3 Transp	ブの設定を行い tray thermost こ設定し、Adv .0 - Advanced rinse steps : 3 (min): 0.0 : that the last step must be T up plus injection mode is us solition Volume (µL) v 500 port v 750 port v 1000	ます。 atting anced

	Agilent 社製の場合】					
1	LC Pump: Binary Pump タブをクリック	クします。				
2	画面の左側に Pump のパラメータ、右側	にタイムラ	ーブルが	表示され	1ます。	
3	流速、移動相組成は、実際に使用する組 mL/min 、Solvents に B 50 % を入力)。	成、流速を	入力します	⊢(Trair	ingでは	t Flow 0.2
			vanced	(s)		
	0.200 mL/min	-				
	Solvents         Solvents           A:         50.0 () %           B:         50.0 () %           Pressure Limits	Time	(min) A [%] 0.00 5 1.00 5 2.00 2 3.00 2 3.10 5 4.00 5	B [%] 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 80.0 0.0 80.0 0.0 50.0 0.0 50.0	Flow [mL/min] 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200	Max. Pressure Limit [bar] 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
	Min: 0.00 bar Max: 400.00 ba	ir				
	As Injector/No Limit     Off     1.00 ; min     1.00 ; min	in				
4	タイムテーブルにグラジエント条件を入	カします。				
(5)	Column Oven : Column Comp.タブをク	リックしま	ま(Traini	ngでは	40℃と	入力)。
6	Autosampler : Sampler タブをクリック	します。		0		
©	Injugation Volume(注入量)を入力します(T	raining 7	けちょしと	ス 力)		
	Injection Volume(11)(1)(2)(1)(2)(1)			/ / / / / 0		
	Injection volume: 5.	μ				
8	必要に応じてバルブの設定を行います	Time (min)	Pr	sition		
	(Training では右記の通り入力)。	0	A	siuon		
		0.1	В			
		5.5	А			
9	上部にある Save ボタンの下矢印をクリッ を入力して保存します(Training では Res	νクして Sε serpine_FI	ive as を追 A と入力)。	選択 し、 。	適当なご	ファイル名

通常の設定の場合、

6 方バルブは

Position A ( 廃液 ): 6-1, 2-3, 4-5 Position B ( MS ): 1-2, 3-4, 5-6

がつながっています。

Pump In Pump In Source Waste

特殊な設定になっている場合もありますので、どの番号のポートから液が出るかをご確認 の上、ご使用ください。

# 【注意】

Valve の切り替え時間は、MS の測定開始時間および終了時間と同じ時間設定にしない でください。

例)0~6 分の分析の場合、0.5~5.5 分の間で切り替え時間を設定します。

## 4.9 測定

### <u>カラムの接続</u>

カラムを接続します(Training では接続しません)。

# <u>システムの平衡化</u>

- Status Panel をクリックし、下部の Equilibrate アイコンを クリックします。
- 平衡化に使用する MS Method および LC Method を プルダウンより選択します。
  - ※ Training では下記のように選択します。
     MS Method : Reserpine\_MRM
     LC Method : Reserpine\_MRM

Direct Control
Equilibrate 🛛 🛛
M5 Method Reserpine_MRM
LC Method Reserpine_MRM V
Time (min.) 1.0 🗘
OK Cancel

- ③ 平衡化する時間を入力し、OK をクリックします(Training では1分)。
  - ※ イオンソース全体の温度が平衡になるのに 10 分程度かかりますので、15 分以上 を推奨します。
  - ※ LC の溶媒が流れ、ガスやターボガスの加熱が始まり、平衡化後に画面右上の Status Panel が *◎* Ready に変わります。

### <u>Batch の作成</u>

以下の方法で測定するサンプルの情報(サンプル名、バイアル番号等)を入力します。

- ① Home 画面の Batch アイコン formula form
- ② Batch 入力画面で測定に使用する情報を入力します(Training では下記の通り入力および選択)。
  - ※ 既存の Batch がある場合は Open から開き、編集し使用することもできます。
  - ※ Rack type および Rack Position、Plate Type、Plate Position は、装置構成に従っ て選択してください。
  - ※ Plate Layout から確認または選択が可能です。
  - ※ Injection Volume は LC メソッドの値が自動で反映されますが、直接入力で変更 することもできます。
  - ※ 既存の解析メソッドがあれば、Processing Method に入力し、結果ファイル名を Results File に入力しておくことで、測定終了後に自動で解析まで完了させること も可能です。
  - ※ 右クリックで Insert sample または Delete sample を選択して追加または削除が 可能です。
  - ※ Excel と同様に、コピー&ペーストやドラッグによる連続入力などの編集が可能で す。また、行で右クリックをすると行の挿入や削除をすることができます。
  - ※ Fill Down および Auto Increment を選択すると選択行以降の入力できます。

	Sample N	lame MS Met		MS Method L		LC Method         Rack           Reserpine_MRM         Vial			Rack Position Plate T		е Туре
1 Reserpine		e Res		erpine_MRM	Reser					1.5m	L Cooled (70 vial)
Plate Position Vial Pos		ition	Injection Volu	me (µl)	Data File		Pro	cessing Method	1	Results File	
		1			5.0	Reserpine_Tra	ining				

- ③ 測定結果は Data File 名ごとに保存されます。Data File 名が同一の場合、複数のデー タが一つのファイルに保存されます。Sample 名が同一でも、上書きされることはあり ません。
  - ※ 保存場所は下記の通りです。

D:\SCIEX OS Data\【Project 名】\Data\【Data File 名】

【ヒント】

Type the numb	er of samples to add		
Number of Samples	20		
Configure the f	following information	n for the	samples
Sample Name	Sample		<ul> <li>Auto Increment</li> </ul>
MS Method	Resrpine_MRM	~	
LC Method	Reserpine_MRM	*	
Rack Type	Vial Rack	~	
Rack Position		~	
Plate Type	1.5mL (105 vial)	~	
Plate Position		~	
Vial Position	1	~	✓ Auto Increment
Injection Volume (ul)	10.0		
Sample Type	Unknown	~	
Data File	2024\1111	•	Auto Increment
Processing Method		~	-
Results File		•	

④ 上部の Save ボタンの下矢印から Save as で名前をつけて Batch を保存します(Training では【日付】で保存)。

### 測定の開始

① 測定を開始する場合は、以下のいずれかの方法で Submit をクリックすると測定が開始 します。

## 【注意】

平衡化が完了していた場合、Submit をクリックすると注入動作が開始します。

- すべてのサンプルを測定する場合は、右上の Submit ボタンをクリックします。
   確認メッセージが表示され、確認後 OK をクリックします。
- 一部のサンプルを測定する場合は、行を選択してから Submit をクリックします。
   確認メッセージが表示され、確認後 OK をクリックします。

Sub	omit Samples 🛛 🛛 🗴
1	Confirm the selection of samples
	Total number of samples to be submitted: 2 of 2
	OK Cancel

- ② Home 画面の Queue アイコンをクリックします。
- ③ Submit した Batch が表示され、ダブルクリックすると Submit されたサンプルの詳細 が表示されます。

Acquisition S	tatus Sample N	lame Est. Start Time	MS Method	LC Method	Injection Volume (µ	l) Data File
O 201227 -     O	2 samples					
	×↓					
Acquisition Status	Sample Name	Est. Start Time	MS Method	LC Method	Injection Volume (µl)	) Data File
201227 - 2 sample	5					
	Reserpine	2020/12/25 14:35:09	Reserpine_MRM	Reserpine_MRM	5	Reserpine_Training
	Reserpine	2020/12/25 14:41:14	Reserpine_MRM	Reserpine_MRM	5	Reserpine_Training

- ※ 測定中の Data を Explore で確認することができます。確認方法は、P.6-1 以降の "データの確認"をご参照ください。
- ④ 測定を途中で停止する場合は、上部の Stop ボタンをクリックし、開始する際に Start ボタンをクリックします。
  - ※ すぐに測定を停止する場合は、Stop now を選択します。
  - ※ 現在測定中のサンプルが終了した後に停止させる場合は、

Stop aftere the corrent tasks are completed を選択します。

- ⑤ Queue の最後のサンプルを測定後、設定時間が経過すると、LC は自動で止まり、MS は Standby の状態に戻ります。
  - ※ 上記の設定時間は Configuration の Queue にある Instrument idle time の時間で 適宜変更可能です。

es	Queue Settings	Save
	Instrument idle time	60 min
ement	Maximum number of acquired samples allowed	300
	✓ If a sample is missing, then proceed to the n	ext sample
ates	<ul> <li>If calibration fails, then proceed to the next s</li> <li>Save the calibration data to the current projet</li> </ul>	ample ect folder instead of the SCIEX OS/

# 5 停止操作

① Home 画面から Configuration をクリックし画面を開きます。



- ② Devices を選択し、上部の Deactivate をクリックします。
  - ※ 必要に応じて LC のみ Deactivate し、MS のみ Activate Device した状態にします。
- ③ ソフトウェアを閉じます。
- ④ HPLC の電源を切ります。
- ⑤ 必要に応じて PC の電源を切ります。

必安に応してよりの	「尿を切ります」	Deactivate	Add Edit	Delete	
Devices		1999 Barrier Ba			
Projects		ExionLC AD		$\checkmark$	Activate
User Management		Type Integrated System	Subdevices Binary Gradient - Pump B		
Queue		ExionLC	Autosampler Column Oven System Controller		
Print Templates		Last Modified	System controler		
Licenses		2025/03/13			
LIMS Communication		SCIEX 7500+ system		$\checkmark$	Activate
General		Type Mass Spectrometer	Subdevices		
Software Updates		SCIEX 7500+ system Sciex			
Service and Support		Last Modified 2025/03/04			

6 データの確認

## <u>データを開く</u>

- ① Home 画面からを Explorer をクリックし Explorer を開きます。
- ② メニューバーの File から、あるいはアイコンの Open Sample を選択します。
- ③ 目的のデータの Wiff ファイル>目的の Sample を選択し、 OK をクリックします(Training では、納品資料 DVD 内の Training\_sulfa 3mix Triple Quad フォルダ中のサンプルをク リックします)。
- ④ 該当のデータファイルが開きます。

### 前後のクロマトグラムを表示する

- ① 上記の順序で該当のデータを開きます。
- ② 前後のクロマトグラムに移る場合は、メニューバーのアイコン ちょうをクリックします。
  - ※ 左矢印 : 一つ前のクロマトグラムが表示されます。
  - ※ 右矢印 🔹 : 次のクロマトグラムが表示されます。
  - ※ 曲がった矢印 :データを選択する画面が開き、任意のクロマトグラムを表示させることができます。

Fi	le	Edit	Sho	w Graph	Process	Bio Tool Kit	Window	Help
2	ê	• ·	<b>+</b> , •	۵ 🔧 🖈	۹ 🔳 🔳	<b>d</b> i di		

#### 分析時の測定条件を確認する

- ① メニューバーの Show から Sample Information を選択します。
- ② 分析条件など、データを取得した際の情報が表示されます。

📉 File Edit	Sho	w Graph Process	Bio Tool Kit	Window	Help						
🚅 🚅 💷 i 🛼	Û	Total Ion Chromatogram	n (TIC)	Ctrl+T							
	Û	Extracted Ion Chromato	gram (XIC)	Ctrl+E	- 5	_					
TIC from curve sul	企	Base Peak Chromatogra	m (BPC)	Ctrl+B							
900 1		IDA Explorer									
		LC/MS Contour Pane									
850 -		UV/DAD/ADC Channel	UV/DAD/ADC Channel Sample Information								
800		LC Traces Data File Properties									
		DAD Total Wavelength Chromatogram (TWC) Original data life name: PFAS_20241128 Original data life name: DiSCEX OS Data/PFAS/Data/PFAS/20241128 wtf2									
750		DAD Extracted Wavelength Chromatogram (XWC) Original computer name. DEKYT0P-55428K0 Software generated data file: SCEK 05 3 0.0 19154									
		DAD Contour Pane				Service version: Device Properties	Clear	Core2.Service 3.4.0.19154			
700 -		Data and Peaks Table					Device	Firmware Version	Serial Number		
		Sample Information		Ctrl+I			Model	PIL2007 PIB1100 PIA1100			
		Hethod Para	System Status ameters			MassSpectrometer	Quad 5500+	(210714 02 A3 D5147809C ) 230213 USL0350 20130613	EX242862409		
		- General - Jon Sour - Experim - Mass T - Initel Instru - General	ce ent blie ment Tables and Paramete	rs		IntegratedSystem	Shimadzu Nexera Series	Pump A - LC-40D XS - 1.12, Autosampler - SIL-40C XS - 1.19, Oven A - CTO-40C - 1.03, System Controller - SCL-40 - 1.67	Pump A - LC-40D XS - L22426203373, Autosampler - SIL-40C XS - L22456201993, Oven A - CTO-40C - L22246210223, System Controller - SCL-40 - L22106205846		
		- Q1 Calib - Q1 Reso	ration Table Jution Table			Valve	Valve Model	1.0.0.0	AB SCIEX 1		
		- Q3 Calb	ration Table			Datch Elle Dropartie					



	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Select S	Sample
_	
Source:	C:¥
:	
	🖃 🛄 Training_sulfa3mix
	🛅 .Audit Data
	Acquisition Methods
	Acquisition Scripts
	🗄 💼 Batch
	Bio Analyst
	🚊 🖳 🛄 Data
	🛓 💼 SDZ_20070612171150
	🚊 🕮 curve_sulfa.wiff
	🛛 🚽 #1 - blank
	🔰 #2 - 0.1
	🔰 #3 - 1
	H #4 10
### マスクロマトグラム(XIC)の表示

<数値を入力する場合>

- ① メニューバーの Show から Extracted Ion chromatogram(XIC)を選択します。
- 2 m/z、Width、化合物名を選択し、OKをクリックします(Training では下図のように選択)。

<マススペクトルから表示する場合>

- 目的のマススペクトルを拡大します。
- ② スペクトルを左ドラッグで選択し、ダブルクリックします。
- ③ 右図のようなメッセージが表示されます。
- ④ OK をクリックします。

XIC Selection Ranges	x
Note: Selections are automatically adjusted to the actual range of the corresponding peaks (at half height).	
Hold the Control key when generating X0Cs to use the ranges without adjustment.	
Only show this dialog again if the shift key is down	
OK Cancel	

⑤ 選択範囲の中で一番強度の強い MS 値±0.2 Da で抽出した XIC が表示されます。



⑥ キーボードの Ctrl キーを押しながら、OK をクリックすると、選択した MS レンジで 抽出した XIC が表示されます。

Select I	MRMs	
Q1		Q3
251.2		108.2
265.2		92.0
311.2		156.3

⑦ 重ね書きされたクロマトグラムに名前を割り当てたり、ピークを塗りつぶすには

Ĩ ▲ アイコンを選びます。 Norverapamol XIC from Verapamil IDA-2.wiff (sample 2) - Verapamil+Norverapamil, Experiment 1, +EMS (300 - 1000): 441.02 to 441.52 Da
Verapamil XIC from Verapamil IDA-2.wiff (sample 2) - Verapamil+Norverapamil, Experiment 1, +EMS (300 - 1000): 455.04 to 455.54 Da Norverapamol / 3.109 3.0e7 Verapamil / 3.316 2.5e7 2.0e7 Intensity 1.5e7 1.0e7 5.0e6 0.0e0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 Time, min

⑧ 重ね書きされた Pane を個々の Pane にする場合は、メニューバーの Graph から Split Traces into Separate Panes を選択します。



### 画面のコピー

① クロマトグラム等をコピーするには、メニューバーの Edit から Copy Graph あるいは Copy Window を選択します。

📉 File	Edit	Show	Graph
🖻 🚅 🗎		Сору	Ctrl+C
	(	Copy Gra	ph
TIC from cu		Copy Wir	ndow 😞

- ② Copy Graph:メタファイル形式、Copy Window:ビットマップ形式です。
- ③ ペイントやパワーポイント等にペーストします。

### 7 SCIEX OS Software を用いた定量解析

本マニュアルでは SCIEX OS Software の Analytics モードを用いて解析を行う方法を 示します。

濃度既知の標準液から作成した検量線をもとに、濃度未知のサンプルの定量を行います。

内部標準物質(IS)を使用した場合は、解析時に指定した内部標準物質によって自動補正 されます。

- Training では Training では、納品資料 DVD 内の Training\_sulfa 3mix Triple Quad フォルダ中のサンプルをクリックします)。
  - Sulfadiazine (SDZ: 251.2/108.2)、Sulfamerazine (SMZ: 265.2/92.0)の検量線の 作成(内部標準物質 Sulfadimethoxine (SDMX: 311.2/156.3)による補正)
  - 未知試料中の SDZ と SMZ の定量
- <参考> 検量線について

検量線(標準濃度曲線)とは、既知の濃度 の標準試料と未知の試料とを比較する ことにより、未知の試料に含まれる物 質の濃度を求める手法です。検量線は、 検体(測定対象物質)の濃度の変化に応 じて検出器がどのように反応するかを 示したグラフ(分析シグナル)です。検量 線を作成するために、未知の検体の想



定濃度を中心とする各種濃度で調整された標準物質を準備する必要があります。

<参考> 内部標準物質について

内部標準物質は、測定時の注入量、MSのイオン化時のサプレッションなどの効果を補 正するために使用します。生体試料など、複雑なマトリックス中で定量解析を正確に行 う必要がある場合に特に推奨されます。



## <u><SCIEX OS Software Analytics モード定量画面></u>

<u><よく使用するアイコン></u>

Project: SCIEX	OSQuad Data_Example Projects   Results	Repo	rting 🔹 👻	Views	*	Process Method 🔹 🗙
	% ■ A ■ A ■ A ■ "C ■ IIN ■ C.H.	•	7 1 7		More	• 👻 🗙
	Displays the Peak Review		Displa	ys the C	libi	ration Curve
	クリックするとクロマトグラムが表		クリン	ックす	ると	:検量線が
	示されます。		表示さ	れます。		

# 7.1 SCIEX OS Software の Analytics の起動

デスクトップ上の SCIEX OS Software アイコンをダブルクリックし、起動します。

ホーム画面に表示されている Analytics のアイコンをクリックします。

# 7.2 Project の選択

画面上部の Projects > 目的の Data の格納されている Project を選択します(Training では Training\_sulfa 3mix Triple Quad を選択)。

s S

				Я	Ø 1	Ready	?
Project: Default Projects	Results	*	Reporting	•	Views	•	Process Metho
✔ Default							
Training_sulfa3mix							
Project default settings							
Project secure export settings							
Enable project modified peak warning							

# 7.3 初期設定の変更

- ① Projects をクリックし、Project Default Settings を選びます。
- Quantitative Processing では、図を参考に、定量解析に使用するアルゴリズムや積分 条件、検量線の条件等を設定します。
  - ※ 各種設定は状況に応じて変更します。

Project Default Settings								
Quantitative Processing +	Set Project wide defaults for qu	antitative p	rocessing method parameters					
Qualitative Processing	Method Defaults							
g	Signal to Noise Algorithm Relative Noise 💙							
Workspace Layout	Integration Defaults							
	Integration Algorithm	1Q4	♥					
	▼ Retention Time (RT)							
	XIC width	0.02	Da					
	Expected RT	0.000	min					
	RT Half Window	30.0	sec					
	Update Expected RT	No 💙						
	Report Largest Peak							
	▼ Integration							
	Minimum Peak Width	3	points					
	Minimum Peak Height	100.00						
	S/N Integration Threshold	0						
	Gaussian Smooth Width	0.0	points					
	Noise Percentage	40.0	%					
	Baseline Subtract Window	2.00	min					
	Peak Splitting	2	points					
	Units & Calibration Defaults —							
	<ul> <li>Units &amp; Calibration Defaults</li> </ul>							
	Concentration units							
	Regression parameter	Area	<b>▼</b>					
	Regression type	Linear	<b>▼</b>					
	Weighting type	None	~					
✓ Apply to current project Use fo	r new projects in current data root More P	rojects 👻						

③ Qualitative Processing では、下図を参考に定性解析に使用するライブラリーサーチや 各種パラメーター等を設定します。

Quantitative Processing	Set Project wide defaults for qualitati	ve pro	cessing method para	meters							
Qualitative Processing 🔸	Library Search	Library Search									
Norkspace Lavout	Library Search Algorithm		Smart Confirmation S	earch		*					
workspace Layout	Results Sorted By		Purity			<b>~</b>					
	Algorithm Parameters										
	Precursor Mass Tolerance	+/-	0.4 Da								
	Collision Energy	+/-	5 eV								
	Retention Time	+/-	0.5 mit	n							
	Fragment Mass Tolerance	+/-	0.4 Da								
	Ignore Isotopes In Unknown		Maximal Numb	er Of Hits	5						
	Vse Polarity		Intensity Thresh	old	0.05						
	Use Collision Energy Spread		Minimal Purity		10.0	%					
	Use Compound Specific Purity	Threshol	d Intensity Factor		5						

## 7.4 Result Table の作成

① 画面上部の Results > New をクリックします。

				à	$\bigotimes$	Ready		? – □ ×
Project: Training_sulfa3mix	Projects	Results	Report	ting	•	Views	•	Process Method 🔹 🗙
		New				able c	ar oponi	ng an existing one
		Open				able c	n openi	ng an existing one.

② Process New Results 画面を開き、Select batch Samples to process で、Available から 解析するデータを選択し、右矢印をクリックして Selected に移動します。(Training で は curve\_sulfa.wiff の全 Data を移動)。



- ③ Process New Results 画面の 2. Select a processing method で、以前に作成した Processing Method(定量解析用 Method)がある場合は Browse...をクリック、使用する 解析メソッドを選択し、Process をクリックし"7.5 Results Table の確認、編集"に進み ます。
  - ※ Processing Method が無い場合、次の頁の"新規に定量解析用メソッドを作成し、 Results Table を作成する"に進みます(Training では新規に作成)。
  - ※ Layout を過去に保存していた場合、Select a workspace layout の Browse...から 選択することが可能です。



### 新規に定量解析用メソッドを作成し、Results Table を作成する

① Process New Results 画面の 2. Select a processing method の New をクリックしま す。

Process New Results	X
1. Select batch samples to process Current Location: C:\SCIEX OS Data\Training_sulfa3mix\Data\ Sort by: A->Z Ascending ✓ Available ▷ SDZ_20070612171150 ▷ II DuaLwiff ▷ II DwRes.wiff ▷ II MRM-EPI.wiff ▷ II ProductScan.wiff	Selected Selected Curve_sulfa.wiff blank 0.1 1 10 100 Sample1 sample2
2. Select a processing method	Browse KNew
3. Select a workspace layout	Browse
4. Select a comparison sample for Non-targeted workflo <none></none>	w •
	Process Cancel Help

- ② 解析メソッドの編集画面が表示されます。
- Workflow で Quantitation and targeted identification のチェックを外し、Quantitation にチェックが入っていることを確認します。

※ ライセンスの種類によりチェックボックスがない場合もあります。

- ④ 代表サンプルが自動的に選択されます。
  - ※ Sample Name をクリックすると代表サンプルが切り替わります。

[MQ4] Untitled Method								x
Workflow •	Select the workflow and then selec	t a reference sam	nle if applicat	ale				
		tu reference sum	pic, il applicat	JIC .				
Components	Quantitation	_						
Integration	Non-targeted screening	'n						
Library Search								
	The recommended Reference Sample has b	een automatically sele	cted. Change the s	election only	if required.			
Calculated Columns	Sample Name	Туре	251.2 / 10	265.2 / 92.0				^
	curve_sulfa.wiff (sample 1) - blank	Blank	0.00	0.00				
Flagging Rules	curve_sulfa.wiff (sample 2) - 0.1	Standard	0.10	0.10				
55 5	curve_sulfa.wiff (sample 3) - 1	Standard	1.00	1.00				
Advanced	curve_sulfa.wiff (sample 4) - 10	Standard	10.00	10.00				
Advanced	curve_sulfa.wiff (sample 5) - 100	Standard	100.00	100.00				
Eormula Eindor	curve_sulfa.wiff (sample 6) - Sample1	Unknown	0.00	0.00				
Formula Finder	curve culfa wiff (cample 7) - cample?	Unknown	0.00	0.00				~
Non-targeted Peaks	<ul> <li>XIC from curve_sulfa.wiff (sample 4) -</li> <li>XIC from curve_sulfa.wiff (sample 4) -</li> <li>XIC from curve sulfa.wiff (sample 4) -</li> </ul>	<ul> <li>10, +MRM (3 transition 10, +MRM (3 transition 10. +MRM (3 transition)</li> </ul>	o <b>ns): 251.2 / 108.2</b> hs): 265.2 / 92.0 Di hs): <u>3</u> 11.2 / 156.3 I	Da a Da				
	o <u>1</u>	<u> </u>	$\mathcal{A}$	Δ				
	0.5 1.0	1.5 2.0 2	.5 3.0	3.5 4.0	4.5	5.0	5.5	
			X-value					
			Save		Close		Help	

- ⑤ Components で化合物名、内部標準物質(IS)の情報を入力します。
  - ※ Training Data では、311/156 が IS です。
  - ※ IS が無い場合は、入力は不要です。

[MQ4] Untitled Method										
Workflow	Sel	ect or	verify	the anal	yte and intern	al standard names a	and masses.			
Components										
Integration	F	Row	IS	Group	Name	Precursor (Q1) Mass (Da)	Fragment (Q3) Mass (Da)	Retention Time (min)	IS Name	Experiment Index
Library Search	2	1			251.2 / 108.2	251.15756	108.2		IS	1 MRM (3 transitions)
		2			265.2 / 92.0	265.19239	92		IS	1 MRM (3 transitions)
Calculated Columns		3			IS	311.21171	156.3			1 MRM (3 transitions)
Flagging Rules		4								

- ⑥ Integration で代表サンプルの自動積分された結果が表示されます。チャンネル(成分)を クリックし、全成分について同様に積分パラメータを設定、確認します。
  - ※ ピークが希望通りに積分されない場合は、下記【スムージングおよび積分パラメータ】を参考に積分パラメータを変更後、Apply をクリックし、クロマトグラムに反映します。
  - ※ パラメータは Results Table 作成後も変更できます。

Workflow	For each compone	ent, configure the parameters	to optimize	peak integratio	on			
Components	Integration Algorithm: I	MQ4						Options
ntegration •	251.2 / 108.2	Retention Time (RT)			251.2 / 108.	.2 (251.2 / 108.2) fro	om 1 (curve_sulfa.wiff (sample 3)) 9. RT 1.71 min	
ibrary Search	IS	Expected RT	1.705	min	rited ob obt		1.71	
alculated Columns		RT Half Window	30.0	sec	60	00-		
		Update Expected RT Report Largest Peak	No 💙		55	50		
igging Rules		▼ Integration			- 50	00-		
		Apply peak parameters to a	all of the compo	nents				
Formula Finder		Minimum Peak Width	3	points	45	50 -		
Non-targeted Peaks		Minimum Peak Height	100.00		40	00-		
		Gaussian Smooth Width	1	points	<u>8</u> 35	50 -		
		Noise Percentage	40.0	%	nsity, c			
		Baseline Subtract Window	2.00	min	a 30	00-		
		Peak Splitting	2	points	25	50 -		
		▼ Units & Calibration Defaults			- 20	00-		
		Apply units and calibration	parameters to a	II of the components	5			
		Concentration units			15	50 -		
		Regression parameter	Area 💙	•	10	00-		
		Regression type	Linear 💙	•		A. A. M. A.	A MARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	
		Weighting type	1/x 💙	•			We	man
		Remove outliers automatics	ally from the cali	ibration curve	_	0 L		••••
				Apply		0.5 1.0	1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 Time, min	5.0 5.5

# 【スムージングおよび積分パラメータ】

・Gaussian Smooth Width:スムージングをかける場合、値を入力します。

・**Min. Peak Height**:ここで設定した高さ(Intensity, cps)を超えるピークを積分します。ベースラ インよりも高めに設定することで、ノイズや強度の低いピークは積分されなくなります。

- ・Noise Percentage:値を大きくする程、ベースラインが上がり、ピーク面積値が小さくなります。
- ・Baseline Sub. Window:ベースラインとして設定する最小強度を検索する幅になります。Peak幅
- の 2-3 倍程度が Default 値になります。
- ・Peak Splitting: 値を大きくする程、割れたピークを一つのピークとして認識しやすくなります。

- ⑦ Calculated Columns をクリックし、必要に応じて設定します。
  - ※ 設定方法は中級定量トレーニングマニュアルをご参照ください。
- ⑧ Flagging Rules をクリックし、真度、定量値の許容誤差について設定します。
  - ※ 基準値から外れた場合、定量結果のセルがピンクにハイライトされます。
  - ※ 設定しない場合はチェックをはずします。
  - ※ イオン比の表示は、中級定量トレーニングマニュアルをご参照ください。
  - ※ Accuracy Acceptance をクリックし、必要に応じて真度の許容誤差を設定します。
  - ※ 設定後、Accept changes and return to Fragging Rules をクリックし、前の画面 に戻ります。

[MQ4] Untitled Metho	d				X			
Workflow	Define a rule to flag resul	Its in the table.						
Components			Add Rule 👻 Delete Rule Imp	port	Export			
Integration	Apply Rule Rule Name		Formulas, Columns and Rules Used					
Library Search	Ion Ratio Ac	ceptance	Columns: Ion Ratio Confidence					
	Accuracy Ac	ceptance	Columns: Accuracy					
Calculated Columns	<ul> <li>Concentration</li> </ul>	on Acceptance	Columns: Calculated Concentration					
Flagging Rules	[MQ4] Untitled M	[MQ4] Untitled Method						
Advanced	Workflow	🗲 Accept	<ul> <li>Accept changes and return to Flagging Rules</li> </ul>					
	Components	Identify	the standards and QCs that are outs	ide of the	e specifications	;		
	Integration	Rule nam	Accuracy Acceptance					
	Library Search	Maximur	n tolerance for accuracy:					
		🗸 Stan	dards at Lower Limit of Quantitation (LLOQ)	+/-	20.0			
	Calculated Column	S 🖌 Stan	dards	+/-	15.0	_		
	Elagging Rules	Qual	ity Controls (QC)	+/-	15.0			

⑨ Concentration Acceptance をクリックし、必要に応じて定量値の許容誤差を設定します。Accept changes and return to Fragging Rules をクリックし、前の画面に戻ります。

Workflow	Define a rule	to flag results in the table.			
Components			Add Rule	nport Export	
ntegration	Apply Rule	Rule Name	Formulas, Columns and Rules Used		
ibrary Search		Ion Ratio Acceptance	Columns: Ion Ratio Confidence		
	$\checkmark$	Accuracy Acceptance	Columns: Accuracy		
Calculated Columns	✓	Concentration Acceptance	Columns: Calculated Concentration		
lagging Rules		Integration Acceptance	Columns: Quality, Asymmetry Factor, Total	Width, Retention Time Error (%)	
[MQ4] Untitle	ed Method				
Workflow	÷	<ul> <li>Accept changes and return to Flaggi</li> </ul>	ng Rules		
Components		Identify the unknown sample	s that are outside of the concentra	tion range	
Integration Rule name Concentration Acceptance					
Library Search		Analyte	Lower Limit	Upper Limit	
Calculated Co	umns	> 251.2 / 108.2			
		265.2 / 92.0			

- ID Save をクリックし、File Name に解析 Method 名を入力し、Save をクリックします (Training では【日付】を入力)。
- Process New Results 画面に戻ります。Process をクリックすることで、解析が開始され、終了後 Result Table(解析結果)が表示されます。
  - ※ Layout を過去に保存していた場合、Select a workspace layout の Browse...から 選択することが可能です。

Save Quantitation Method As	feet     Search Quantitation Methods	Process New Results	×
Organize     New folder       Image: Second S	Image: Constraint of the second sec	1. Select batch samples to process Current Location: C:\Analyst Data\Projects\Training_sulfa3mix\Training_sulfa3mix\Data\ Soft by: Available P 0 502,2007621271150 P 0 Dualwiff P 0 onAntio_Sulfa3mix_20170904.wiff P 0 towRes.wiff P 0 NonRes.wiff P 0 ProductScan.wiff P 0 ProductScan.wiff P 0 Sample1 Campba2	srowse
Computer System (C.) DATA (D) Struct (D) St	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2. Select a processing method C(\Analyst Data\Projects\Training_sulfa3mix\Training_sulfa3mix\Quantitation Browse New 3. Select a workspace layout 4. Select a comparison sample for Non-targeted workflow <none> Process Cancel Can</none>	Edit Browse

### 7.5 Results Table の確認、編集

 Samples タブでは、任意のサンプルを選択できます。Results Table はサンプルごとに 表示されます。

Analytics	í	ר ב			٨	ă 📀	) Ready	,	? – □ ×
	Project: Tra	ining_sulfa3mix Pro	ojects	✓ Results	• Report	ting 👻	Views	♥ Pi	rocess Method 🔹 🗙
Samples Components and Groups	[MQ4] Res	ults Table (Untitled)							
Options 👻	Ъ I	% A A	/az 🗾 🤇	"c III C"I	<mark>५    ▼</mark> ि	7 \Xi \Xi 🗉		More	• 🛛 😸 🗙
0.1	Index	Sample Name 🛛	Sample T ⊽	Component Name ♥	Component Type ⊽	Retention Time ⊽	Area 🗸	Actual Concentration	▼ Calculated ▼ Concentration ▼
10	1	blank	Blank	251.2 / 108.2	Quantifiers	N/A	N/A	N/A	N/A
100	▶ 2	blank	Blank	265.2 / 92.0	Quantifiers	2.70	4.232e2	N/A	2.198e-1
	3	blank	Blank	311.2/156.3	Internal Stand	3.49	2.207e3	1.00	N/A

 Components and Groups タブでは、任意の Analyte を選択します(Training では 251/108 を選択)。

🗘 - Analytics		☆   🖄				٨	à	$\odot$	Ready	/	? – □ ×
	Project: Ti	aining_sulfa3mix	Projects		✤ Results	♥ Rep	orting	•	Views	•	Process Method 👻 🗙
Samples Components and Groups	[MQ4] Re	sults Table (Untitled)									
Options 👻	<u>ጉ</u> 2	%	A /oz		"C 📕 航 🗖 🖓	H. 📃 🔹 🗠	7 2 3	3 6		More	• 🗾 😸 🗙
All Components	Index	Sample Name 🔽	Sample Type	Y	Component Name ⊽	Component Type	▼ Retention Time	ہ ر	Area ⊽	Actual Concentration	Calculated Concentration
All Internal Standards	▶ 1	blank	Blank	~	251.2 / 108.2	Quantifiers	N/A		N/A	N/A	N/A
511.2/130.5	2	blank	Unknown		265.2 / 92.0	Quantifiers	2.70		4.232e2	N/A	2.198e-1
	3	blank	Standard		311.2/156.3	Internal Stand.	3.49		2.207e3	1.00	N/A
All Analytes	4	0.1	Blank	Я	251.2 / 108.2	Quantifiers	1.72		9.533e2	0.10	9.553e-2
251.2 / 108.2	5	0.1	Double Blank		265.2 / 92.0	Quantifiers	2.71		1.471e3	0.10	8.399e-2
265.2 / 92.0	6	0.1	Solvent		311.2/156.3	Internal Stand.	3.48		1.307e4	1.00	N/A

- ③ Sample Type を確認、編集します。
  - ※ 変更する場合はプルダウンメニューから、標準液: Standard、QC サンプル: Quality Control、ブランク: Blank、サンプル: Unknown を選択してください。
- ④ Actual Concentration に標準液の調整濃度を確認、入力後 Enter キーを押して更新し ます。(Training では 0.1、1、10、100 と入力)
  - ※ Excel などからのコピー(Ctrl+C)、ペースト(Ctrl+V)可能です。
  - ※ 全化合物について濃度を確認、入力します。
  - ※ 全化合物の濃度が同じ場合は、1 化合物のみ入力後、カラム上を右クリックし、
     Apply Current Analyte's Actual Concentrations to All を選択すると標準液濃度
     が全化合物に反映されます。

Сору	Ctrl+C					
Paste	Ctrl+V					
Copy Entire Table						
Fill Down	Ctrl+D					
 Select All Rows						
Apply Current Analyte's Actual Concentrations to All						
 Apply Current IS's Actual Concentrations to All						

⑤ サンプルの定量値が、Calculated Concentration に表示されます。

- 7.6 クロマトグラムの表示
- ① Results Table 画面右上の 📈 をクリックしてクロマトグラムを表示させます。

ſ	[MQ4] Resu	ults Table (Untitled)							
	ر 1	%	A /az	"c 📕 航 🗖 C	"H" 📃 👻 💽 [	7 2 7		More	• 🛛 😸 🗙
	Index	Sample Name 🛛	Sample Type ⊽	Component Name	Z Component Type ⊽	Retention Time ⊽	Are	plays the Peak Re	eview culated entration $\nabla$

- ③ 必要に応じて、表示されているクロマトグラム数(縦、横数)について変更する場合は、
   Options > Peak review display settings を選択します。Peak review Options 画面上部の
   の Number of rows、Number of columns で変更後、OK をクリックしてください。

Samples	Components and Groups	[MQ4] Pea	k Review (Untitled)											
	Options 👻	<b>℃</b>   2	%	A Az	"c 📕 ılı 📕 C	,H. 📃	•	₹.	88		2	More	• ] 🛛	×
All Comp	onents nal Standards	Index	Sample Name 🏹	Sample Type ⊽	Component Name	Con	nponent Type	, Retent Tim	tion e ⊽	Area	7	Actual Concentration ▽	Calculated Concentration	.^
311.2/15	6.3	▶ 16	Sample1	Unknown	251.2 / 108.2	Quar	itifiers	1.70		3.220e4		N/A	3.550e-1	
1	0.5	17	Sample1	Unknown	265.2 / 92.0	Quan	ntifiers	2.69		5.548e4		N/A	4.828e-1	~
All Anah	tes	<											2	>
251.2 / 1	08.2							_	_	_	_			_
265.2 / 9	2.0	A A	Manual Integ	gration 🛛 🛃 🛛 🛃	🔬 🔄		388	View		~	0	ptions	9 2 2	$\mathbf{X}$
1					Apply	Samp	le1 - 25e lr	ndex: 6)	Samp	le1 - 26e	-	Peak review dis	play settings	*
1		▼ Reten	tion Time (RT) —		î	Area:	3.220e1: 1.	.70 min	Area:	5.548e1		% Y-axis (MS/M	IS spectra only)	
1		Expect	ed RT	1.705	min		3000	1.699		7000	~	Fill peak (XIC an	id spectra)	
1		RT Half	f Window	30.0	sec		2500			6000		Mirror MS spect	tra	
1		Update	• Expected RT	No	<b>v</b>		2000			5000	~	Mirror MS/MS s	spectra	
1		B	enort Largest Peak		<u> </u>	nsity			nsity.	4000		Integration para	ameters	
1		▼ Integr	ration			Inte	1500		hte	2000		Cat Chan Caida	- hitt	
1		Minim	um Peak Width	3	points		1000			2000		Get Chemopide	r hit count	
1		Minim	Deak Height	100.00			500			2000	×.	Show navigation	n controls	
1		C (h) los	In Peak Neight	100.00	-					1000 -		Copy All Graphs	5	
1		S/N Int	egration Threshold	0			0 1	.5 2.0		0 -	ł.	Copy Active Gra	aph	
		Gaussia	an Smooth Width	0.0	points		Tin	ne, min			1	e, mm	nine, nim	Ŧ

Peak Re	view Op	otions			X
Appearance	Zooming	XIC Graph Title			
Number of	rows:	1		*	
Number of	columns:	3		•	
		••••••			
Overlay:		Don't overlay		♥	
Peak Fill Sty	le:	Dotted		*	
🗌 Mark e	xpected RT	with arrow			
Manual Inte	egration(Pe	ercent Rule) 0		*	
Reject manua	l integration	if difference in ne	w area is less than spe	cified % of original	area
			ОК	Cancel	Help

- 7.7 パラメータの変更
- 必要に応じてクロマトグラム左に表示されているパラメータ値を変更し、クロマトグラムのピーク認識方法を変更します。

	Project: Training_sulfa3mix Project	ts 🔹 Results	* Reporting	♥ Views	Process Method      ×
Samples Components and Group	s [MQ4] Peak Review (Untitled)				
Options		l A₂ °C III	CH. ▼ 0 7	888 🔼	🗸 More 🔽 😸 🗙
All Components	Index Sample Name 文	Sample Type V Componer Name	nt Component Type	Retention Are	Actual T Calculate
All Internal Standards	► 16 Sample1	Unknown 251.2 / 108.	2 Quantifiers	1.70 3.220	De4 N/A 3.550e-1
311.2/156.3	17 Sample1	Unknown 265.2 / 92.0	Quantifiers	2.69 5.548	3e4 N/A 4.828e-1 v
All Analytes	<				>
251.2 / 108.2	A A Manual Inter	tration 🔽 🐧 두		iew 👻 (	Ontions 🔹 🗖 🖉 🔀 🗙
265.2 / 92.0	in and integ	Ар	ply 100 - 311.2/156. Area: 1.181e4, H	3(sample Index: 5) ei5e3, RT: 3.48 min	Sample1 - 251.2 /(sample Index: 6)
	Retention Time (RT)     Expected RT	1.705 min	4000 3500	3.476	3000
	RT Half Window	30.0 sec	3000 -		2500 -
	Update Expected RT	No 💙	2500 -		2000 
	Report Largest Peak		u 2000 -		<u>- 1500</u>
	Integration     Minimum Peak Width	3 points	1500		1000
	Minimum Peak Height	100.00	500		500
	S/N Integration Threshold	0	0 k	nannel Johnson	0 15 20
	Gaussian Smooth Width	1 points	÷	3.5 Time, min	Time, min
·	<b></b>				

- ② 各パラメータの詳細については、P.7-7【スムージングおよび積分パラメータ】を参照ください。
- 変更後 Apply をクリックすると、選択したサンプルピークに変更したパラメータが反映されます。

#### 全サンプルピークに変更したパラメータを反映させる

- ① 選択したサンプルに値を反映させた後、クロマトグラム上を右クリックします。
- ② Update Processing Method for Component を選択します。



## 7.8 手動積分

※ 必要に応じて行います。

- ① クロマトグラム画面上部の 🔼 をクリックします。
- ② ピークの左端をクリックします。
- ③ そのままドラックし、ピークの右端で離します。
- ④ もとのパラメータに戻す場合は Manual Integration 右横のチェックを外してください。





- 7.9 検量線の表示、重みづけ、検量線の種類を変更
- ① Results Table 画面右上の 🔽 をクリックし、検量線を表示します。
  - 表示位置を調整する場合は、 📴 をドラックして赤い線が出たら離すと移動します。



- ② 必要に応じて Regression をクリックし、重みづけや検量線の種類を変更します (Training では下図のように設定)。
  - Regression Parameter : Area→Hight の変更
  - Regression Type: 検量線の種類の変更
  - Weighting Type: 重みづけの変更



③ 必要に応じて画面上部の Results > Save as で定量結果を保存します。

# 7.10 データの追加と削除

### <u>データの追加</u>

- Results Table 画面右上の More > Add Samples を選択し、Available で追加したいサン プルを選択後、右矢印をクリックし、Selected に移動します。
- ② OK をクリックすると、Results Table に追加されます。

oject: Training_sulfa3mix Projects	♥ Results	♥ Reporting	♥ Views	<ul> <li>Process Method</li> </ul>
re 🗸 🔁 🔀			Regression	n Options 👻 🖌 😹
Table display settings	n for 265.2 / 92.0: y = 0	).58007 x + 0.06430 (r =	: 0.99973, r <sup>2</sup> = 0.9994	46) (weighting: 1 / x)
Add custom column				/
Rename custom column	50 -			
Remove custom column				
Hide selected row(s)	40 -			
Show previously hidden row(s)				
Add samples	30 -			
Remove selected samples		/		

Select Samples X	Select Samples X
Select the desired samples	Select the desired samples
Current Location: C:\Users\minako.tanaka\Downloads\APIALL-DVD8\API and QTRAP\Tr Browse Sort by: A>=Z Ascending Available Selected Curve_sulfa wrift Cu	Current Location: C:\Users\minako.tanaka\Downloads\APIALL-DVD8\API and QTRAP\Tr Browse Sort by: A+>Z Ascending  ▲ Available b SDZ_20070612171150 b @ Dualwiff b @ Loukes.wiff b & Louk
□     □       □ </td <td>E MRM-EPI.wiff     ProductScan.wiff</td>	E MRM-EPI.wiff     ProductScan.wiff
<u>Q</u> K <u>Cancel</u>	OK Cancel

## <u>データの削除</u>

**Results Table** で削除したい行を選択し、**Results Table** 画面右上の **More** > **Remove Selected Samples** を選択することで削除されます。

※ 削除後、元に戻すことはできません。必要に応じて削除前に画面上部の Results > Save as で定量結果を保存してください。

### 7.11 Report の作成

- ① 画面上部の Reporting > Crate report and save Results Table を選択します。
- Create Report 画面が表示されますので、Template Name のプルダウンで目的に沿っ たレポートテンプレートを選択します。
  - ※ Default の Template は、C:¥ProgramData¥SCIEX¥Analytics¥Reporter に保存 されています。
  - ※ その他、<u>https://sciex.jp/support-tools/analyst-multiquant-reporttemplate</u>からダ ウンロード可能です。
- ③ Report title の Browse をクリックしてファイル名の入力と保存先を選択します。
- ④ Create をクリックするとレポートが作成されます。

	Create Report X						
Reporting   Views	Generate a report using a predefined template and specified logo						
Create report and save Results Table	Template name ② Calibration Curve	1					
Export results     Export MarkerView Generic Text     Initiate Transfer to Watson LIMS     Transfer results to LIMS     Print and save Results Table	Template description Report showing File Information, Statistics Table (standards) and Calibration Curve for analytes, 1 page per analyte.						
	Report format OV BDF CSV HTML						
	Report title ③ Calibration Curve_Report_2018_05_17_165643 Browse						
	Create an individual report for each sample (Recommended for large reports; Report titles will be appended with sample reference) Create Close						



				Created with Analysis Reporter						
SCIEX			P	Inted: 18/05/2018 11:05:26 AM						
Analyte: AfaB1 (285.0510 Data File Acquisition Date Acquisition Method Project	0 - 285.1010) 15_01_BK_1.wlf2 11/29/2017 3.20.15 AM 05_MRMHR_pos_mic X500R-007385_YA_KS_AA	Result Table Algorithm Use Instrument No	d N me X	SCIEX		Created with Analy Printed: 18/05/2018 1	ist Reporter 1:05:26 AM			
Sample N	kame Sampi Type	<ul> <li>Area (cps)</li> </ul>	RT (min)	Blank RT (Exp. RT): 8.48 (8.58) mir		8.479				
Dark Class	Diark.	9.3938+00	8.48	Calculated < 0 ppb Const	· ·		SCIEX		,	Created with Analyst Report Printed: 18/05/2018 11:05:26 A
STD 0.02ppb STD 0.05ppb	Standard Standard Standard	5.635e+01 9.391e+01	8.58	Area: 9.393e0 Sample Type: (Blank)		O O O O O O O	STD_1000			8 572
STD_0.1ppb STD_0.2ppb	Standard Standard	1.127e+02 3.194e+02	8.56 8.58	STD_0.01008			RT (Exp. RT):	8.57 (8.58) min	de la constante de	
STD_0.5ppb STD_1ppb	Standard Standard	7.4208+02	8.58	(Calculated < 0 ppb	1	8.604	Catcales Canci	1.29960		<u></u>
STD Sppb	Standard Standard	6.914e+03 1.415e+04	8.59	Area: 9.392e0 Sample Type: (Standard)	,L		Sample Type: STD_2ppb	(Standard)	100	
STD_20000 STD_50000	Standard Standard	2.794e+04 6.080e+04	8.58 8.58	STD_0.02ppb	1	8.579	RT (Exp. RT):	8.57 (8.58) min	1 =	8.575
STD_2ppb	Quality	4.694e+01 2.367e+03	8.50	RT (Exp. RT): 8.58 (8.58) mit (Calculated) 2.059+2 pob	1		Calculated Conct	1.935e0 ppb	20	
STD_2ppb	Quality Control	2.968e+03	8.57	Conci Area: 5.635e1		12 13 14 15 15 15 15 Toron min	Sample Type:	(Standard)	891	Tree no
STD_2ppb	Control	2.501e+03	8.58	STD_0.05ppb	ж.	8 578	RT (Exp. RT):	8.59 (8.56) min	1	8.586
STD 2000	Control Quality	2.6296+03	8.58	RT (Exp. RT): 8.58 (8.58) mit	1	0.070	[Calculated Cont3	5.338e0 ppb	1	
STD_2000	Contról	2.4698+03	8.58	Conc) Area: 9.391e1	.1		Area: Sample Type:	6.91460 (Standard)	· • • • • •	85 84 87 88 88 88 Tens.net
STD_2ppb	Quality	2.520e+03	8.59	Sample Type: (Standard) STD_0.1ppb	-		RT (Exp. RT):	8.58 (8.58) min		8.577
Sample B Sample B	Unknown Unknown	1.550e+03 1.850e+03	8.57 8.57	RT (Exp. RT): 8.56 (8.56) mit		8.564	Calculated	1.095e1 ppb	2 200 - 100	
Sample B Sample_B	Unknown	1.681e+03 2.015e+03 2.005e+03	8.58	Calculated 6.427e-2 ppb Cont3 Area 1.127e2	-		Arez Sample Type	1.415e4 (Standard)	0.0.0	B B D B B B
Sample B Sample B	Unknown	1.815e+03 2.206e+03	8.57 8.57	Sample Type: (Standard) STD 0.2000	100.1	Ting mit	STD_20ppb	151 (151) min		8.578
				RT (Exp. RT): 8.58 (8.58) mit		8.581	(Calculated	2.164e1 ppb	3 500-	A
				[Calculated 2.245e-1 ppb Conc):	3 0	A	Area Sample Type	2.794e4 (Standard)	1 0 0 0	n n n n n n
				Area: 3.194e2 Sample Type: (Standard)		12 13 14 15 14 17 18 Ten.mit	STD_50ppb		2000	8.576
				RT (Exp. RT): 8.55 (8.55) min		8.577	Calculated	4.712e1 ppb	1 -	A
				[Calculated 5.522e-1 ppb Conc)			Ares Sample Type:	6.000e4 (Standard)		13 14 17 18 19 19 Tons.no
				Area: 7.420e2 Sample Type: (Standard)		10 10 14 15 10 17 10 Treams	Bak		1	8.564
							(Calculated	8.56 (8.56) min 1.329e-2 ppb	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Maria
							Conci Area	4.69491		43 44 87 83 83 52 Tang an
							sample type:	(Diank)	1	

Page 3 of 35

研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用は出来ません。

製品には、同梱された電源コードセットを使用して下さい。 また、同梱された電源コードセットは、他の製品には使用しないで下さい。

AB Sciex is doing business as SCIEX.

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

The trademarks mentioned herein are the property of AB Sciex Pte. Ltd. or their respective owners.

AB SCIEX<sup>™</sup> is being used under license.

詳細な説明や知的所有権等に関しては付属のマニュアルを必ずご確認ください。

© 2025 K.K. AB SCIEX.